



中华人民共和国国家标准

GB/T 7410.1—2025

代替 GB/T 7410—1987

搪瓷制品和瓷釉 术语 第 1 部分：术语和定义

Vitreous and porcelain enamels—Terminology—Part 1: Terms and definitions

(ISO 19496-1: 2017, MOD)

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 通用术语 1

 3.2 搪瓷制备术语 5

 3.3 设备、工具术语 15

 3.4 搪瓷制品术语 18

 3.5 理化和技术性能术语 21

 3.6 缺陷术语 25

 3.7 检测方法术语 31

附录 A（资料性） 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 35

附录 B（资料性） 本文件与 ISO 19496-1:2017 的技术差异及其原因 49

索引 52

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 7410《搪瓷制品和瓷釉 术语》的第1部分。GB/T 7410 已经发布了以下部分：
——第1部分：术语和定义。

本文件代替 GB/T 7410—1987《搪瓷名词术语》，与 GB/T 7410—1987 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了制备通用术语中金属毛坯、静电干粉、干法铸铁搪瓷粉的术语和定义(见 3.1.2.2, 3.1.2.12, 3.1.2.13)；
- b) 增加了金属基材术语中搪瓷铝、搪瓷铸铁、搪瓷钢板、冷轧钢、热轧钢、脱碳钢的术语和定义(见 3.1.5.1~3.1.5.6)；
- c) 增加了熔块组分术语中抗氧化剂、解凝剂、抗菌剂、中和剂、填充料、防锈剂、丝网油墨、介质的术语和定义(见 3.2.1.7~3.2.1.14)；
- d) 更改了钛白釉术语的定义(见 3.2.4.1, 1987 年版的 2.4.1)；
- e) 增加了面釉类型术语中钛彩釉的术语和定义(见 3.2.4.2)；
- f) 增加了釉浆、釉粉组成术语中预处理剂的术语和定义(见 3.2.6.5)；
- g) 增加了金属坯体表面处理术语中喷磨、配色、抛丸、蒸汽脱脂的术语和定义(见 3.2.9.7, 3.2.9.10~3.2.9.12)；
- h) 增加了涂搪工艺术语中直接涂搪、传统涂搪、浇釉、浸渍、干粉蘸涂、干喷、热洒涂、浇搪、粉末-粉末涂搪、去边釉、造粒、边部涂搪的术语和定义(见 3.2.10.9, 3.2.10.12~3.2.10.22)；
- i) 增加了饰花工艺术语中贴花纸的术语和定义(见 3.2.11.10)；
- j) 增加了烧成工艺术语中粉涂、气封的术语和定义(见 3.2.12.2, 3.2.12.8)；
- k) 增加了返修工艺术语中修边的术语和定义(见 3.2.13.7)；
- l) 增加了工艺参数术语中粉末粘附力、膨胀系数、恢复时间、喷雾速率的术语和定义(见 3.2.14.13~3.2.14.16)；
- m) 增加了熔制设备术语中直接烧成炉的术语和定义(见 3.3.1.6)；
- n) 增加了涂搪设备、工具术语中孔刷、福特杯、再循环浸渍缸、釉浆稠度计、喷枪的术语和定义(见 3.3.2.9~3.3.2.13)；
- o) 增加了烧成工具术语中修边刷、酸浸筐、三角烧架的术语和定义(见 3.3.4.7~3.3.4.9)；
- p) 增加了按工艺分类搪瓷术语中两搪一烧制品的术语和定义(见 3.4.1.6)；
- q) 增加了按特性分类搪瓷术语中哑光搪瓷的术语和定义(见 3.4.3.1)；
- r) 搪玻璃容器术语定义中“设备”更改为“非压力容器”(见 3.4.4.6)；
- s) 增加了按用途分类术语中日用制品/中空制品、拼装罐的术语和定义(见 3.4.4.9, 3.4.4.10)；
- t) 增加了其他分类术语中自着色搪瓷、花岗岩纹搪瓷、半透明搪瓷、书写板搪瓷、易清洁搪瓷、静电搪瓷、预磨粉的术语和定义(见 3.4.5.1~3.4.5.7)；
- u) 增加了釉粉、釉浆性能术语中流动性、流变性、触变性、黏度的术语和定义(见 3.5.2.5~3.5.2.8)；
- v) 增加了搪瓷制品性能术语中易污性、可染性、耐化学性、耐熔性、气孔率、孔隙率、光洁度、溶解度的术语和定义(见 3.5.3.20~3.5.3.27)；

- w) 增加了金属坯体和粉坯缺陷术语中粉化、法拉第笼效应、轧制铁鳞、氧化皮的术语和定义(见 3.6.1.6~3.6.1.9);
- x) 增加了制品缺陷术语中黑点、蚀刻、珍珠线、焊接处泡孔、猪皮皱、坑、孔隙、波纹、滑动、剥落、珠子、破气泡、流挂、凸块、大理石效应、泛霜、印痕、不连续性、流浆线、下垂、开裂、延迟鱼鳞爆、波浪线纹、过喷、反向发射的术语和定义(见 3.6.2.35~3.6.2.59);
- y) 增加了熔块检测术语中拉丝试验的术语和定义(见 3.7.1.3);
- z) 增加了釉浆、釉粉检测术语中细度试验、容重试验的术语和定义(见 3.7.2.4,3.7.2.5);
- aa) 更改了碳酸钠溶液侵蚀试验术语的定义(见 3.7.3.16,1987 年版的 7.3.14);
- bb) 增加了制品检测术语中冲击试验、海绵试验、拭子试验的术语和定义(见 3.7.3.20~3.7.3.22);
- cc) 删除了激碎的术语和定义(见 1987 年版的 2.7.3);
- dd) 删除了罐磨机的术语和定义(见 1987 年版的 3.1.7)。

本文件修改采用 ISO 19496-1:2017《搪瓷制品和瓷釉 术语 第 1 部分:术语和定义》。

本文件与 ISO 19496-1:2017 相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录 A。

本文件与 ISO 19496-1:2017 相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线(|)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录 B。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会(SAC/TC 57)归口。

本文件起草单位:浙江开尔新材料股份有限公司、湖南信诺技术股份有限公司、东华大学、上海第二工业大学、中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司。

本文件主要起草人:丁林锋、周向华、叶佳意、李金铭、秦泽瑜、曹益亭、郭艳、鲁冉冉、刘津、王贺兰、罗理达、蒋伟忠、安江峰。

本文件于 1987 年首次发布,本次为第一次修订。

引 言

GB/T 7410 旨在规范搪瓷制品和瓷釉产品所涉及的专业术语和定义,拟由两个部分构成。

- 第 1 部分:术语和定义。目的在于通过明确界定搪瓷制品和瓷釉相关领域的术语和定义,以规范搪瓷行业术语的应用。
- 第 2 部分:外观表现及描述。目的在于通过图片形象展示搪瓷制品和瓷釉相关的缺陷特征,以明确区分各类缺陷术语。

搪瓷制品和瓷釉 术语

第 1 部分:术语和定义

1 范围

本文件界定了搪瓷制品和瓷釉相关领域的术语和定义。

本文件适用于搪瓷制品和瓷釉及其相关领域的生产、设计、科技、贸易、检测和管理等。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 通用术语

3.1.1 基础通用术语

3.1.1.1

搪瓷 vitreous enamel; porcelain enamel

珐琅 enamel

通常是玻璃状无机二氧化硅为主体的材料熔凝于**基体金属**(3.1.1.5)上,并与金属形成牢固结合的复合材料。

3.1.1.2

搪玻璃 glass-lined steel; glass coated steel; glassed steel

工业搪瓷

具有较强的防腐蚀和耐温抗压性能的一类**搪瓷**(3.1.1.1)。

注:一般应用于化工领域。

3.1.1.3

熔块 frit

一定组成的无机原料经混合、熔融并急剧冷却后形成的无机玻璃质材料。

注:通常为粒状或薄片状,其中粒状熔块是由**熔体**(3.1.2.8)排出到水中急冷而成,而薄片熔块是由熔体在水冷辊碾压下急冷而成。

3.1.1.4

瓷釉 enamel

熔块(3.1.1.3)经磨加黏土、电解质及氧化色料后得到的物料。

3.1.1.5

基体金属 substrate

用于表面涂覆**瓷釉**(3.1.1.4)的金属材料。

3.1.1.6

坯体 base substrate

用于涂覆瓷釉(3.1.1.4)的半成品的总称。

3.1.2 制备通用术语

3.1.2.1

金属坯料 metal blank

待制作成型件的金属材料。

3.1.2.2

金属毛坯 blank

已切割的用于加工成品的未处理金属板。

3.1.2.3

金属坯体 metal body

由金属坯料支撑或铸成的成型件。

3.1.2.4

粉坯 bisque body

金属坯体(3.1.2.3)上涂覆瓷釉(3.1.1.4)尚未进行高温烧制的半成品。

3.1.2.5

素坯 white ware

粉坯(3.1.2.4)经高温烧制后得到的半成品。

3.1.2.6

花坯 decorated ware

素坯(3.1.2.5)上用瓷釉(3.1.1.4)装饰得到的半成品。

3.1.2.7

配合料 batch

按瓷釉(3.1.1.4)组成配制的原料的混合物。

3.1.2.8

熔体 smelt

处于熔融状态的配合料。

3.1.2.9

釉浆 slip

由熔块(3.1.1.3)、水和其他调整性能的物质混合磨制而成的悬浮状物料。

3.1.2.10

釉粉 powdered frit

由熔块(3.1.1.3)磨制成的干粉料。

3.1.2.11

粉层 bisque

经干燥后的粉坯(3.1.2.4)涂层。

3.1.2.12

静电干粉 electrostatic powder

涂有携带静电荷以传输一定粒径的粒子的包裹剂的搪瓷粉末。

3.1.2.13

干法铸铁搪瓷粉 powdered enamel

通过筛分或蘸涂施加到炽热的铸铁坯体上的瓷釉(3.1.1.4)粉。

注：与静电干粉不同。

3.1.2.14

搪瓷制品 enamel product

以搪瓷(3.1.1.1)工艺制作的产品。

3.1.2.15

搪玻璃设备 glassed steel equipment

以搪玻璃(3.1.1.2)工艺制作的设备。

3.1.2.16

熔制 melting

配合料在高温下熔化成均匀熔体(3.1.2.8)的过程。

3.1.2.17

表面处理 surface treatment

对金属坯体(3.1.2.3)表面进行的除污、除锈及沉积膜层等的过程。

3.1.2.18

涂搪 enameling; application

在经过表面处理的金属坯体上均匀涂覆一层或多层瓷釉(3.1.1.4)的操作。

3.1.2.19

饰花 decoration

在素坯(3.1.2.5)表面用瓷釉(3.1.1.4)装饰的过程。

3.1.2.20

烧成 firing; burning

粉层在规定温度下熔烧成搪瓷(3.1.1.1)的过程。

3.1.2.21

返修 secondary treatment

搪瓷(3.1.1.1)生产过程中修复变形的坯体或受损的瓷釉(3.1.1.4)涂层的工序。

3.1.3 结构通用术语

3.1.3.1

瓷层 enamel coating

熔附于基体金属(3.1.1.5)上的瓷釉层。

3.1.3.2

搪玻璃层 glass-lined coating

熔附于基体金属(3.1.1.5)上的搪玻璃瓷层(3.1.3.1)。

3.1.3.3

底釉层 ground coat

对于多层搪瓷,直接与基体金属(3.1.1.5)接触的瓷层(3.1.3.1)。

3.1.3.4

面釉层 cover coat

对于多层搪瓷,涂覆于底釉层(3.1.3.3)上的瓷层(3.1.3.1)。

3.1.3.5

密着层 adhesive layer

烧成后基体金属(3.1.1.5)和底釉层(3.1.3.3)之间形成的过渡层。

3.1.3.6

气泡结构 bubble structure

烧成后瓷层(3.1.3.1)中的气泡尺寸和空间分布。

3.1.4 设备通用术语

3.1.4.1

熔炉 melter

熔制瓷釉(3.1.1.4)配合料的高温炉。

3.1.4.2

烧成炉 furnace

烧成搪瓷(3.1.1.1)的高温炉。

3.1.4.3

烧成工具 firing tools

烧成过程中用作悬挂或支撑已涂搪(3.1.2.18)坯体的工具。

3.1.5 金属基材术语

3.1.5.1

搪瓷铝 enameling aluminum

适合用作涂搪(3.1.2.18)的铝基材。

3.1.5.2

搪瓷铸铁 enameling cast iron

适合用作涂搪(3.1.2.18)的铸铁基材。

3.1.5.3

搪瓷钢板 enameling steel

适合用作涂搪(3.1.2.18)的钢板基材。

3.1.5.4

冷轧钢 cold-rolled steel

经退火的冷轧低碳钢板。

3.1.5.5

热轧钢 hot-rolled steel

经高温轧制和酸洗(3.2.9.2)的低碳钢板。

3.1.5.6

脱碳钢 decarburized steel

零碳钢 zero carbon steel

碳含量极低的特种钢板。

注 1: 适用于酸洗(3.2.9.2)和披镍(3.2.9.3)后直接涂覆白色面釉层。

注 2: 脱碳钢在烧制过程中变形较小,适用于大型板材等。

3.2 搪瓷制备术语

3.2.1 熔块组分术语

3.2.1.1

基体剂 base stock

形成熔块(3.1.1.3)基本网络结构的主体物质。

3.2.1.2

助熔剂 flux

降低配合料熔融温度的物质。

3.2.1.3

乳浊剂 opacifier

赋予或增强瓷层(3.1.3.1)对光的漫反射能力的物质。

3.2.1.4

密着剂 adhesive agent

促进瓷釉(3.1.1.4)与基体金属(3.1.1.5)在烧成过程中牢固结合的物质。

3.2.1.5

氧化剂 oxidizer

增强烧成过程氧化气氛的物质。

3.2.1.6

着色剂 colorant

赋予瓷层(3.1.3.1)以不同色彩的物质。

3.2.1.7

抗氧化剂 anti-scale compound

为减少在烧成(3.1.2.20)过程中氧化而应用于烧成工具和其他物品上的一种化合物。

3.2.1.8

解凝剂 de-setting agent

用于降低釉浆(3.1.2.9)黏度(3.5.2.8)的电解质(3.2.6.3)。

3.2.1.9

抗菌剂 biocide

用于抑制发酵的有机添加剂(如胶类)。

3.2.1.10

中和剂 neutralizer

用于去除预处理后残留在工件表面的多余酸或碱的试剂。

3.2.1.11

填充料 plugging compound

填料 filler

为确保涂搪(3.1.2.18)时表面光滑,而对铸铁件上的孔进行填充所用的腻子状釉料。

3.2.1.12

防锈剂 rust inhibitor

用于防止金属氧化的化合物。

注:防锈剂是一种用于抑制在搪瓷涂搪(3.1.2.18)和烧成(3.1.2.20)过程中基体金属(3.1.1.5)生锈的电解质。

3.2.1.13

- 丝网油墨 screening ink
- 网印油墨 screening paste
- 陶瓷油墨 ceramic ink

用于丝网印刷中悬浮在介质中的助熔剂(3.2.1.2)和着色剂(3.2.1.6)的混合物。

3.2.1.14

- 介质 medium
- 调墨油 squeegee oil

用于丝网油墨(3.2.1.13)中悬浮着色剂(3.2.1.6)和助熔剂(3.2.1.2)的油或油的混合物。

3.2.2 瓷釉类型术语

3.2.2.1

- 透明釉 transparent frit
- 烧成后基本保持透明或不乳浊的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.2.2

- 色釉 colored frit
- 烧成后具有色彩的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.2.3

- 乳油釉 opaque frit
- 烧成后表现出明显漫反射、不透明特性的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.2.4

- 回收釉 waste enamel;reclaim
- 回收经处理后得到的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.2.5

- 底釉 ground-coat enamel
- 涂覆在基体金属(3.1.1.5)上形成底釉层(3.1.3.3)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.2.6

- 面釉 cover-coat enamel
- 涂覆在底釉层(3.1.3.3)上形成面釉层(3.1.3.4)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.2.7

- 边釉 beading enamel
- 涂覆在坯体边缘部的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.3 底釉类型术语

3.2.3.1

- 镍底釉 nickel enamel
- 以镍的化合物作为密着剂(3.2.1.4)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.3.2

- 钴底釉 cobalt enamel
- 以钴的化合物作为密着剂(3.2.1.4)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.3.3

锑钼底釉 antimony—molybdenum enamel

以锑和钼的化合物作为密着剂(3.2.1.4)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.4 面釉类型术语

3.2.4.1

钛白釉 titanium enamel

以二氧化钛作为乳浊剂(3.2.1.3)的白色釉。

3.2.4.2

钛彩釉 colored titanium enamel

以二氧化钛作为乳浊剂(3.2.1.3)的彩色釉。

3.2.4.3

锑白釉 antimony enamel

以锑的化合物作为乳浊剂(3.2.1.3)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.4.4

锆白釉 zirconia enamel

以锆的化合物作为乳浊剂(3.2.1.3)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5 特性瓷釉术语

3.2.5.1

搪玻璃釉 enamel for glassed steel

制作搪玻璃(3.1.1.2)的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.2

耐酸釉 acid resistant enamel

对除氢氟酸外的酸溶液具有一定稳定性的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.3

耐碱釉 alkali resistant enamel

对碱溶液具有一定稳定性的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.4

低温釉 low temperature enamel

烧成温度(3.2.14.7)相对较低的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.5

发光釉 luminous enamel

含有一定组分的发光物质,在外加能源激发下能发出可见光的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.6

铸铁瓷釉 cast iron enamel

制作以铸铁为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.7

铝搪瓷釉 aluminum enamel

制作以铝材为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.5.8

铜搪瓷釉 **copper enamel**

制作以铜材为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷的瓷釉(3.1.1.4)。

3.2.6 釉浆、釉粉组成术语

3.2.6.1

磨加物 **mill addition**

研磨熔块(3.1.1.3)时添加的能调整瓷釉(3.1.1.4)性能的物质。

3.2.6.2

停留剂 **setting-up addition**

研磨熔块(3.1.1.3)时添加的用于调整釉浆(3.1.2.9)流变性(3.5.2.6)能的物质。

3.2.6.3

电解质 **electrolyte**

在釉浆(3.1.2.9)中发生电离并吸附或排斥釉浆颗粒的物质。

3.2.6.4

悬浮剂 **suspension agent**

能使釉浆(3.1.2.9)中颗粒呈悬浮状态的物质。

3.2.6.5

预处理剂 **cleaner**

用于去除金属基材表面的油、脂、润滑剂和松散氧化层的溶液。

3.2.7 釉浆、釉粉制备术语

3.2.7.1

干磨 **dry grinding**

熔块(3.1.1.3)在无液体介质条件下研磨成釉粉(3.1.2.10)的过程。

3.2.7.2

湿磨 **wet grinding**

熔块(3.1.1.3)在液体介质中研磨成釉浆(3.1.2.9)的过程。

3.2.7.3

陈化 **aging**

老化 **ageing**

经过磨制的釉浆(3.1.2.9)或釉粉(3.1.2.10)存放一定时间以稳定其性能的过程。

3.2.8 金属坯体制备术语

3.2.8.1

切片 **blanking disk**

将金属板材裁剪成一定形状和尺寸的工序。

3.2.8.2

冲压 **deep drawing**

使用冲压机床和模具将金属坯料压制成型的工序。

3.2.8.3

剪卷 trimming and beading; curing

将金属坯体(3.1.2.3)边缘剪齐并滚卷成型的工序。

3.2.8.4

胀径 bulging

拉胖 bulging

将金属坯体(3.1.2.3)沿径向均匀扩张和延展成型的工序。

3.2.8.5

收口 necking

将金属坯体(3.1.2.3)口径尺寸均匀缩小的工序。

3.2.8.6

平皱 roller-smoothing

研光 roller-flattening

对金属坯体(3.1.2.3)表面在延压过程中产生的波浪形深痕进行平整的工序。

3.2.8.7

割口 edge trimming

将金属坯体(3.1.2.3)口部边缘割齐的工序。

3.2.8.8

磨光 finishing

将金属坯体(3.1.2.3)表面(包括边口、焊缝)的不平整处及夹铁、毛刺等磨平的工序。

3.2.9 金属坯体表面处理术语

3.2.9.1

脱脂 degreasing

用化学或热处理除去金属坯体(3.1.2.3)表面油脂的过程。

3.2.9.2

酸洗 pickling

用一定浓度的酸溶液除去金属坯体(3.1.2.3)表面氧化物和其他化合物的过程。

3.2.9.3

披镍 nickel dipping

金属坯体(3.1.2.3)在镍盐溶液中产生电化学反应使坯体表面沉积镍膜的过程。

3.2.9.4

预烧 pre-burning; annealing

金属坯体(3.1.2.3)在一定温度和时间下消除应力、清除表面氧化物和油污杂质的过程。

3.2.9.5

光亮退火 bright-annealing

金属坯体(3.1.2.3)在中性气体中进行预烧的过程。

3.2.9.6

喷砂 sand blasting

用金刚砂、钢丸等固体金属、硅砂等矿物,或合成树脂、植物颗粒等高速喷射到金属坯体(3.1.2.3)表面清除表面氧化物或其他杂质的过程。

3.2.9.7

喷磨 abrasive blasting

使用磨料对金属坯体(3.1.2.3)进行高速清洁或磨光的过程。

3.2.9.8

中和 neutralization

金属坯体(3.1.2.3)经酸洗(3.2.9.2)处理后用稀碱溶液除去残留酸液的过程。

3.2.9.9

电解酸洗 electrolysis pickling

以金属坯体(3.1.2.3)和酸洗槽作为电极,酸溶液作为电解质进行酸洗(3.2.9.2)的过程。

3.2.9.10

配色 colour matching

通过引入色素,配制与目标样品颜色相近釉料的过程。

3.2.9.11

抛丸 grit blasting

用不规则的小块钢件或可锻铸铁高速撞击金属坯体(3.1.2.3)进行表面清洁和研磨的过程。

注:或类似形状的非金属颗粒,例如,碳化硅或氧化铝。

3.2.9.12

蒸汽脱脂 vapour degreasing

通过溶剂蒸汽冷凝于被清洗的金属坯体(3.1.2.3)以去除油和油脂的过程。

3.2.10 涂搪工艺术语

3.2.10.1

干法涂搪 dry process enameling;dredging enameling

将釉粉(3.1.2.10)均匀附着于炽热状态的坯体表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.2

湿法涂搪 wet process enameling

将釉浆(3.1.2.9)均匀涂覆于坯体表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.3

浸渍涂搪 dipping enameling

将坯体浸入釉浆(3.1.2.9)后用手工或机械操作使釉浆均匀涂覆于坯体表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.4

电泳涂搪 electrophoresis enameling

在直流电磁场作用下使釉浆(3.1.2.9)颗粒泳动均匀沉积于坯体表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.5

浇注涂搪 slushing enameling

将釉浆(3.1.2.9)淋浇于坯体表面后用手工或机械操作使釉浆均匀涂覆于坯体表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.6

流动涂搪 draining enameling

具有良好流动性能的釉浆(3.1.2.9)涂覆于坯体表面后使坯体按一定轨迹运动以排去多余釉浆的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.7

真空涂搪 vacuum enameling

釉浆(3.1.2.9)在外界压力作用下进入真空状态的坯体内腔并均匀吸附于内表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.8

静电涂搪 electrostatic enameling

用静电感应方法使带电荷的釉浆(3.1.2.9)或釉粉(3.1.2.10)均匀吸附于坯体表面的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.9

直接涂搪 direct-on-enameling

直接涂在金属基体上用作底釉层(3.1.3.3)或面釉层(3.1.3.4)的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.10

排浆 drain process

排除坯体表面多余釉浆(3.1.2.9)使之涂覆均匀的过程。

3.2.10.11

滚边 bead enameling

将釉浆(3.1.2.9)均匀涂覆于坯体边缘部卷边处的工序。

3.2.10.12

传统涂搪 conventional enameling

适用于底釉层(3.1.3.3)和面釉层(3.1.3.4)的,每道工序均要烧成的涂搪(3.1.2.18)方法。

3.2.10.13

浇釉 cupping

在排浆(3.2.10.10)期间为提高某些区域的覆盖率而将搪瓷釉浆(3.1.2.9)浇注在该区域上的过程。

3.2.10.14

浸渍 dipping

将坯体浸入釉浆(3.1.2.9)并通过排浆(3.2.10.10)去除多余釉浆的过程。

3.2.10.15

干粉蘸涂 dipping

在干法涂搪(3.2.10.1)时,将炽热的坯体短暂蘸取釉粉(3.1.2.10)的过程。

3.2.10.16

干喷 dry spray

制品湿喷过程中,由于表面没完全喷湿而在其表面呈现出的粗糙、砂质纹理现象。

3.2.10.17

热洒涂 hot dusting

将釉粉(3.1.2.10)筛分涂覆在炽热状态的坯体表面的工艺。

3.2.10.18

浇搪 slushing

通过倾倒、浸渍(3.2.10.14)或将釉浆淋浇于坯体表面,并通过摇晃去除多余的釉浆(3.1.2.9)以获得均匀的涂层的过程。

3.2.10.19

粉末-粉末涂搪 powder-powder enameling

在未烧制的粉末底釉层(3.1.3.3)上施加粉末面釉(3.2.2.6)涂层,然后进行烧成的过程。

3.2.10.20

去边釉 de-beading

去除浸渍制品边缘多余的搪瓷釉浆(3.1.2.9)的过程。

3.2.10.21

造粒 fritting

将熔融瓷釉淬冷并粉碎成易碎的小熔块颗粒的过程。

3.2.10.22

边部涂搪 rim enameling; beading

搪瓷制品边部的涂搪(3.1.2.18)工艺。

3.2.11 饰花工艺

3.2.11.1

印花 printing

色釉(3.2.2.2)釉浆透过印刷模板转移到素坯(3.1.2.5)表面的饰花方法。

3.2.11.2

喷花 spraying decoration

色釉釉浆喷射到罩有花模板的素坯(3.1.2.5)表面的饰花方法。

3.2.11.3

移花 transfer decoration

将贴花纸(3.2.11.10)上的图案色釉(3.2.2.2)转移到素坯(3.1.2.5)表面的饰花方法。

3.2.11.4

刷花 brush-decoration

花模板覆盖于粉坯(3.1.2.4)表面,用刷子除去模板镂空处的干燥涂层形成图案的饰花方法。

3.2.11.5

堆花 filling decoration; poling decoration

色釉(3.2.2.2)逐点堆积于素坯(3.1.2.5)表面形成立体图案的饰花方法。

3.2.11.6

洒冰花 specking decoration

色釉(3.2.2.2)釉浆洒在素坯(3.1.2.5)表面形成不规则图案的饰花方法。

3.2.11.7

喷影光 shading

色釉(3.2.2.2)釉浆由浅到深局部喷射到素坯(3.1.2.5)表面的饰花方法。

3.2.11.8

描金 gold depicting

用金水在制品上勾图和绘边的饰花方法。

3.2.11.9

照相饰花 photographic decoration

在含有感光材料的瓷层(3.1.3.1)表面用照相法饰花的方法。

3.2.11.10

贴花纸 decal

转移花纸 transfer

用陶瓷油墨(3.2.1.13)将图案或文字印刷在纸上并转移到已烧成的搪瓷(3.1.1.1)表面,再次烧成后

能形成牢固搪瓷涂层的饰花材料。

3.2.12 烧成工艺术语

3.2.12.1

烘干 **drying**

涂覆釉浆(3.1.2.9)的坯体在一定温度下干燥的过程。

3.2.12.2

粉涂 **dust coat**

将搪瓷干粉洒涂在样品表面的过程。

3.2.12.3

直接火烧成 **direct firing**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)与火焰直接接触的烧成方法。

3.2.12.4

间接火烧成 **indirect firing**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)与火焰互相隔离的烧成方法。

3.2.12.5

感应烧成 **induction firing**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)在以电磁感应热源作用下进行烧成的方法。

3.2.12.6

辐射管烧成 **radiant-tube firing**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)在金属辐射管产生的辐射热作用下进行烧成的方法。

3.2.12.7

烧花 **decorate fire;decorating fire**

花坯(3.1.2.6)的烧成过程。

3.2.12.8

气封 **air seal**

气幕 **air curtain**

使用加压空气流过连续烧成炉(3.3.3.2)的入口和出口以防止热量从炉中溢出的方法。

3.2.13 返修工艺术语

3.2.13.1

补粉 **touch up**

用少量釉浆(3.1.2.9)涂覆瓷面不完整处的过程。

3.2.13.2

回烧 **reburning**

在前一工序条件下再次烧成(3.1.2.20)的过程。

3.2.13.3

修补 **repairing**

对瓷层(3.1.3.1)表面不完整处进行修复的过程。

3.2.13.4

除瓷 **de-enameling**

除去素坯(3.1.2.5)或制品表面瓷层(3.1.3.1)的过程。

3.2.13.5

补烧架印 patching of firing tool marks

对烧成时瓷层(3.1.3.1)表面留下的烧成工具痕(3.6.2.32)而进行补瓷的过程。

3.2.13.6

磨修 stoning

用小砂轮等磨具磨去瓷层(3.1.3.1)表面不平整处的过程。

3.2.13.7

修边 edging

去除搪瓷制品边缘粉层以露出底层搪瓷的过程。

注：修边也用于描述将特殊的釉浆(3.1.2.9)喷洒到制品边缘上。

3.2.14 工艺参数术语

3.2.14.1

熔化温度 melting temperature

配合料在高温条件下以一定的熔化速率形成熔体(3.1.2.8)的温度。

3.2.14.2

软化温度 softening temperature

瓷釉(3.1.1.4)在加热条件下开始流动的温度。

3.2.14.3

浸渍量 plate weight

经浸渍涂搪(3.2.10.3)的坯体表面单位面积所留存的釉浆量。

3.2.14.4

流浆时间 drain time

经浸渍(3.2.10.14)、流动涂搪(3.2.10.6)和浇注涂搪(3.2.10.5)等方法涂搪(3.1.2.18)的坯体表面的釉浆流淌结束所需的时间

3.2.14.5

干重 dry weight

经烘干的粉坯(3.1.2.4)表面单位面积粉层量。

3.2.14.6

粉层强度 biscuit strength

粉坯(3.1.2.4)上干燥涂层经受外力作用而无损伤的能力。

3.2.14.7

烧成温度 firing temperature

粉坯(3.1.2.4)烧制成搪瓷所需的特定温度。

3.2.14.8

烧成时间 firing time

粉坯(3.1.2.4)烧制成搪瓷所需的时间。

3.2.14.9

烧成幅度 firing range

烧成过程所允许的时间和温度范围。

3.2.14.10

重新升温时间 comeback; reheating time

处于低温状态的烧成炉再次升温到烧成温度所需的时间。

3.2.14.11

输送链速度 chain speed

连续烧成炉(3.3.3.2)中输送链的运转速度。

3.2.14.12

瓷层厚度 coating thickness

瓷层表面到基体金属(3.1.1.5)表面的垂直距离。

3.2.14.13

粉末粘附力 adhesion of powder

搪瓷粉末在烧制前通过静电引力保持附着在接地基材上的能力。

3.2.14.14

膨胀系数 coefficient of expansion

在一定的温度范围内,随着温度升高,试样的膨胀量与温度间隔及试样初始尺寸之比。

3.2.14.15

恢复时间 recovery time

恢复 comeback

加入一批半成品后,炉子温度恢复到原温度所需的时间。

3.2.14.16

喷雾速率 spray-rate

单位时间内喷枪(3.3.2.13)喷出的釉浆量或粉末量。

3.3 设备、工具术语

3.3.1 熔制设备

3.3.1.1

坩埚炉 pot furnace

用坩埚熔制配合料的熔炉。

3.3.1.2

间歇式熔炉 batch smelter; discontinuous smelter

以一定周期间隔供料、熔融和出料的熔炉。

3.3.1.3

连续式熔炉 continuous smelter

供料、熔融和出料连续进行的熔炉。

3.3.1.4

回转式熔炉 rotary smelter

绕水平轴缓慢转动以连续搅拌熔料的熔炉。

3.3.1.5

电熔炉 electric melting furnace

以电加热方式熔制配合料的熔炉。

3.3.1.6

直接烧成炉 **direct fired furnace**

燃烧火焰与制品直接接触的窑炉。

3.3.2 涂搪设备、工具

3.3.2.1

涂搪机 **machine for enameling**

利用机械在坯体上涂覆釉浆(3.1.2.9)的设备。

3.3.2.2

打印滚边机 **machine for stamping and edging**

能连续完成打印章和滚边釉工序的机械装置。

3.3.2.3

压力罐 **pressure tank**

能以压缩空气压出釉浆(3.1.2.9)的容器。

3.3.2.4

浸渍缸 **dip tank**

以金属作为衬里材料贮存釉浆(3.1.2.9)的容器。

3.3.2.5

喷涂室 **spray booth**

开有喷釉窗口、内设排风和瓷釉(3.1.1.4)回收系统的仓室。

3.3.2.6

洒粉筛子 **dredge**

用于干法涂搪(3.2.10.1)的具有一定孔径的筛子。

3.3.2.7

带罐喷枪 **cup spray gun**

附有储釉罐的喷枪(3.3.2.13)。

3.3.2.8

球磨机 **ball mill**

以石球或瓷球等为磨料的圆筒形旋转磨机。

3.3.2.9

孔刷 **bolt-hole brush**

用于清除制品小开口及周围的搪瓷粉层(3.1.2.11)的刷子。

3.3.2.10

福特杯 **ford cup**

用于测量粉末通过指定体积流出时间的装置。

3.3.2.11

再循环浸渍缸 **re-circulating dip tank**

配有使内容物持续循环流动装置的容器。

3.3.2.12

釉浆稠度计 **slip gauge**

测量釉浆(3.1.2.9)稠度(3.5.2.2)的工具。

3.3.2.13

喷枪 spray gun

通过调节用量、雾化程度和喷雾模式将雾化的搪瓷釉浆(3.1.2.9)或粉末涂层涂到部件上的装置。

3.3.3 烧成设备术语

3.3.3.1

箱式烧成炉 box furnace

按一定周期间歇完成烧成过程的高温炉。

3.3.3.2

连续烧成炉 continuous furnace

能连续完成粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)的进炉、预热、烧成、冷却、出炉等流程的高温炉。

3.3.3.3

辐射管烧成炉 tube furnace

以燃烧气体通过合金管道所产生的辐射热进行烧成的隔焰炉。

3.3.3.4

U形烧成炉 U-type furnace

具有U字形输送轨道的连续烧成炉(3.3.3.2)。

3.3.3.5

预热区 preheat zone

连续烧成炉(3.3.3.2)中烘干的粉坯(3.1.2.4)在烧成前进行预先加热的区域。

3.3.3.6

冷却区 cooling zone

连续烧成炉(3.3.3.2)中能使处于炽热状态的烧成品按一定速率冷却的区域。

3.3.3.7

烧成区 firing zone

位于连续烧成炉(3.3.3.2)中部、温度维持在烧成温度期间制品在烧成时间内通过的区域。

3.3.3.8

马弗炉 muffle furnace

具有烧成室且燃烧产生热量通过室壁进行传递的隔焰炉。

3.3.4 烧成工具术语

3.3.4.1

烧车 fork truck

将大型搪瓷制品或搪瓷玻璃制品送入或移出烧成炉的工具车。

3.3.4.2

烧叉 fork

将待烧的粉坯(3.1.2.4)、花坯(3.1.2.6)等移入或取出箱式烧成炉(3.3.3.1)的金属工具。

3.3.4.3

烧架 buck; burning tool**烧架支撑杆 burning bar****烧架支撑点 burning point**

烧成(3.1.2.20)时支撑制品的支架。

3.3.4.4

多层烧架 decking

分层放置粉坯(3.1.2.4)、花坯(3.1.2.6)的烧架。

3.3.4.5

梳齿支架 comb-rack

用以一定间隔排列的支撑杆组成的支架。

3.3.4.6

吊架 hanging racks

由耐热震性和抗氧化性强的合金制成的悬吊式烧成工具。

3.3.4.7

修边刷 edging brush

用于在烧制操作前从制品边缘去除搪瓷粉层(3.1.2.11)的金属丝硬刷。

3.3.4.8

酸浸筐 pickle basket

由耐腐蚀材料制成的用于在酸洗(3.2.9.2)过程中盛放金属坯体(3.1.2.3)的容器。

3.3.4.9

三角烧架 triangle bars

三面支撑的烧架。

3.4 搪瓷制品术语

3.4.1 按工艺分类

3.4.1.1

一次烧成制品 one-fire finish

金属坯体(3.1.2.3)上涂覆一层或多层瓷釉(3.1.1.4)经一次烧成的搪瓷制品。

3.4.1.2

一次搪瓷制品 one-coat ware

金属坯体(3.1.2.3)上仅涂覆一层瓷釉(3.1.1.4)的制品。

3.4.1.3

面釉单搪制品 one-cover-coat ware

底釉层(3.1.3.3)上涂覆一层面釉(3.2.2.6)的制品。

3.4.1.4

面釉双搪制品 two-cover-coat ware

底釉层(3.1.3.3)上涂覆两层面釉(3.2.2.6)的制品。

3.4.1.5

双面搪瓷制品 double ware

金属坯体(3.1.2.3)的两面或里外均涂覆瓷釉(3.1.1.4)的制品。

3.4.1.6

两搪一烧制品 two coat-one fire enameling

涂覆底釉(3.2.2.5)和面釉(3.2.2.6)经一次烧成的搪瓷制品。

3.4.2 按材质分类

3.4.2.1

钢板搪瓷 sheet steel enamel

以钢板作为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.2.2

铸铁搪瓷 cast iron enamel

以铸铁作为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.2.3

铜搪瓷 copper enamel

以铜或铜合金作为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.2.4

铝搪瓷 aluminum enamel

以铝或铝合金作为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.2.5

不锈钢搪瓷 stainless steel enamel

以不锈钢作为基体金属(3.1.1.5)的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3 按特性分类

3.4.3.1

哑光搪瓷 matt enamel

低光泽(3.5.3.6)度的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.2

微晶搪瓷 ceramic—glass enamel

瓷层(3.1.3.1)中含有微晶体的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.3

吸热搪瓷 eat-absorbing enamel

瓷层(3.1.3.1)中含有能吸收红外线物质的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.4

发光搪瓷 luminescent enamel

瓷层(3.1.3.1)中含有能在外界能源激发下产生可见光物质的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.5

无光搪瓷 matt enamel

瓷层(3.1.3.1)表面基本无可见光反射的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.6

医疗生化搪瓷 medical and biochemical enamel

瓷层(3.1.3.1)中包含具有医疗生化功能的特种元素的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.7

纤维增强搪瓷 fiber—reinforced enamel

瓷层(3.1.3.1)中含有无机纤维(或晶须)的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.8

自洁搪瓷 self-cleaning enamel

在烘烤过程中表面油脂斑迹能自行消失的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.3.9

催化自洁搪瓷 catalytic enamel

在一定温度和催化剂的共同作用下能使油污自行分解、挥发的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.4 按用途分类术语

3.4.4.1

日用搪瓷 domestic enamel

制作面盆、口杯、烧器、食具等制品的搪瓷(3.1.1.1)总称。

3.4.4.2

卫浴搪瓷 sanitary enamel

制作浴盆、盥水器、便器等制品的搪瓷(3.1.1.1)总称。

3.4.4.3

建筑搪瓷 architectural enamel

制作墙板、壁面、屋顶、门窗和管道等制品的搪瓷(3.1.1.1)总称。

3.4.4.4

珍宝搪瓷 jewelers enamel

在铜或其他贵金属坯体(3.1.2.3)上涂覆色釉(3.2.2.2)制成的工艺品搪瓷(3.1.1.1)总称。

3.4.4.5

标牌搪瓷 sign enamel

制作招牌、字牌、广告牌和指示牌等制品的搪瓷(3.1.1.1)总称。

3.4.4.6

搪玻璃容器 glassed steel vessels

在金属容器的表面搪烧搪玻璃釉(3.2.5.1)的非压力容器。

3.4.4.7

搪玻璃压力容器 glassed steel pressure—vessels

在金属容器表面搪烧搪玻璃釉(3.2.5.1)的耐压容器。

3.4.4.8

搪玻璃反应罐 glassed steel chemical reactor

在一定温度及压力下能承受腐蚀性物质进行化学反应的搪玻璃容器(3.4.4.6)。

3.4.4.9

日用制品 hollowware

中空制品

炊具 cookware

烤箱用制品 ovenware

厨房用具如瓶罐、平底锅和水壶、耐热器皿等。

注 1: 中空制品按体积细分。

注 2: 餐具在烹制食品和饮品的过程使用常规加热方法。

3.4.4.10

拼装罐 bolted vitreous and porcelain enamelled steel tanks

采用搪瓷钢板通过螺栓连接拼装而成的圆柱形储罐。

3.4.5 其他分类

3.4.5.1

自着色搪瓷 self-mottled ware

由含有两种或多种对比色熔块(3.1.1.3)的浆料制成的均匀颜色背景中出现另一种颜色颗粒的装饰性搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.5.2

花岗岩纹搪瓷 graniteware; mottled enamel

均匀颜色或色调的背景中出现另一种颜色颗粒的装饰性搪瓷(3.1.1.1)。

注：见自着色搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.5.3

半透明搪瓷 semi-opaque enamel

烧成(3.1.2.20)后可以观察到下面的部分涂层或基底的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.5.4

书写板搪瓷 chalkboard enamel

黑板搪瓷 blackboard enamel

用于粉笔或其他书写笔书写的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.5.5

易清洁搪瓷 easy-to-clean enamel

ETC 搪瓷 ETC enamel

经过专门配方制备,可轻松去除其表面的食物、污垢或沉积物等的搪瓷(3.1.1.1)。

注：ETC 搪瓷既不需要热解也不需要催化。

3.4.5.6

静电搪瓷 electrostatic enamel

通过静电形式将搪瓷粉吸附到金属基板上,并烧制成的搪瓷(3.1.1.1)。

3.4.5.7

预磨粉 ready-to-use enamel

RTU 搪瓷 RTU enamel

使用前与水混合的用于湿法加工筛分即用的预研磨搪瓷混合物。

3.5 理化和技术性能术语

3.5.1 熔块性能

3.5.1.1

熔度 fusibility

固态熔块(3.1.1.3)在加热条件下熔化成液态的难易程度。

3.5.1.2

熔流性 fusion flow

熔融的液态瓷釉(3.1.1.4)的相对流动性能。

3.5.2 釉粉、釉浆性能

3.5.2.1

细度 fineness

干磨(3.2.7.1)或湿磨(3.2.7.2)后瓷釉(3.1.1.4)颗粒的大小。

3.5.2.2

稠度 consistency

表征釉浆(3.1.2.9)的流变特性。

3.5.2.3

悬浮性 suspension

釉浆(3.1.2.9)颗粒呈悬浮状态的特性。

3.5.2.4

停留性 set up;set

釉浆(3.1.2.9)在坯体表面排流及滞留的特性。

3.5.2.5

流动性 fluidity

静电粉在充气时形成悬浮状流动的特性。

3.5.2.6

流变性 rheology

釉浆(3.1.2.9)的流动特性。

3.5.2.7

触变性 thixotropy

悬浮液在摇动或搅拌后黏度(3.5.2.8)降低的特性。

3.5.2.8

黏度 viscosity

流体的黏滞阻力系数。

3.5.3 搪瓷制品性能

3.5.3.1

瓷层连续性 continuity of coating

瓷层(3.1.3.1)上出现发沸(3.6.2.12)、针孔(3.6.2.1)、气泡(3.6.2.15)、铜头(3.6.2.21)等影响耐腐蚀性能的缺陷的程度。

3.5.3.2

密着性 adherence

表征底釉层(3.1.3.3)与基体金属(3.1.1.5)之间结合强度的性能。

3.5.3.3

残余应力 residual stress

残存于瓷层(3.1.3.1)内部的应力。

注：因底釉层(3.1.3.3)与基体金属(3.1.1.5)之间、底釉层(3.1.3.3)与面釉层(3.1.3.4)之间膨胀系数不匹配，或者金属坯体(3.1.2.3)结构不合理而产生的。

3.5.3.4

遮盖力 covering power

瓷层(3.1.3.1)遮盖基体金属(3.1.1.5)或底釉层(3.1.3.3)不被暴露的能力。

3.5.3.5

乳浊度 opacity

瓷层(3.1.3.1)对可见光漫反射的能力。

3.5.3.6

光泽 gloss

瓷层(3.1.3.1)表面的光亮程度。

3.5.3.7

白度 whiteness; white degree

白色瓷层(3.1.3.1)的乳浊度(3.5.3.5)。

3.5.3.8

可清洁性 cleanability

瓷层(3.1.3.1)表面污迹可被清除的难易程度。

3.5.3.9

耐冲击强度 impact resistance

瓷层(3.1.3.1)承受外力冲击的能力。

3.5.3.10

耐磨性 abrasion resistance

瓷层(3.1.3.1)表面抵抗固体材料磨损的能力。

3.5.3.11

耐热性 heat resistance

瓷层(3.1.3.1)承受高温的能力。

3.5.3.12

耐温急变性 thermal shock resistance

瓷层(3.1.3.1)承受温度急剧变化的能力。

3.5.3.13

耐酸性 acid resistance

瓷层(3.1.3.1)表面承受酸性物质侵蚀的能力。

3.5.3.14

耐碱性 alkali resistance

瓷层(3.1.3.1)表面承受碱性物质侵蚀的能力。

3.5.3.15

耐水性 boiling water or water vapor resistance

瓷层(3.1.3.1)表面承受沸水或水蒸气侵蚀的能力。

3.5.3.16

耐压性 pressure resistance

承受压力的能力。

3.5.3.17

耐冷冲击性 sudden cooling resistance

在热状态下骤冷所能承受的最大温差。

3.5.3.18

耐热冲击性 resistance to sudden heating

在冷状态下骤热所能承受的最大温差。

3.5.3.19

气密性 air tightness

搪玻璃设备对气体的密封性能。

3.5.3.20

易污性 soilability

外来物质附着在瓷层(3.1.3.1)表面的容易程度。

3.5.3.21

可染性 stainability

瓷层(3.1.3.1)被异物渗透和着色的难易程度。

3.5.3.22

耐化学性 chemical resistance

瓷层(3.1.3.1)承受化学物质腐蚀的能力。

3.5.3.23

耐熔性 hardness; refractoriness

搪瓷(3.1.1.1)或熔块(3.1.1.3)的相对耐火度。

3.5.3.24

气孔率 porosity

瓷层(3.1.3.1)中存在空隙的程度。

3.5.3.25

孔隙率 porosity

催化自洁搪瓷(3.4.3.9)吸收油或脂肪物质的能力。

3.5.3.26

光洁度 satin finish

无定向纹理的,有光泽(3.5.3.6)(但不是镜面)的表面微观不平整程度。

3.5.3.27

溶解度 solubility

在一定的温度和时间条件下,熔块(3.1.1.3)在特定介质中溶解的质量。

3.5.4 搪瓷设备形位公差术语

3.5.4.1

搅拌器上端径向跳动 radial shake of upper end of agitator

搅拌器主轴上端径向同一截面的最外各点到轴中心线的距离之差。

3.5.4.2

搅拌器下端径向跳动 dial shake of lower end of agitator

搅拌器主轴下端径向同一截面的最外各点到轴中心线的距离之差。

3.5.4.3

温度计套管直线度 perpendicularity of thermowell

温度计套管的轴中心线与通过顶端中心水平面的垂线的最大偏差。

3.5.4.4

法兰压紧面宽度 **width of pressed—face of flange**

通过法兰平面直径的水平直尺与法兰边平面连续贴合的最小间隙。

3.5.4.5

法兰平面度 **planeness of flange**

法兰平面与水平面贴合的平整程度。

3.5.4.6

搅拌孔法兰平行度 **parallelism of agitator—hole flanges**

通过搅拌孔法兰平面的直径的水平直尺的两端与罐盖法兰平面之间距离的最大差值。

3.5.4.7

支座对中性 **centering of gearbox supports**

减速器支座安装时所对应的盖支架螺孔中心到盖中心线之间的距离的最大误差。

3.6 缺陷术语

3.6.1 金属坯体和粉坯缺陷

3.6.1.1

瘪 **concavity**

金属坯体(3.1.2.3)加工或流转过程中受到碰撞、挤压等产生的凹坑。

3.6.1.2

坯体皱褶 **waviness of metal body**

金属坯体(3.1.2.3)在机械成型过程中表面产生的波浪形条痕和褶皱深痕。

3.6.1.3

缺粉 **lack of bisque**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)上的粉层(3.1.2.11)缺损的现象。

3.6.1.4

干裂 **drying crack**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)上的粉层(3.1.2.11)裂开的现象。

3.6.1.5

锈点 **rust spot**

涂覆底釉(3.2.2.5)的粉坯(3.1.2.4)在烘干过程中出现的棕褐色斑点。

3.6.1.6

粉化 **bloom**

瓷层(3.1.3.1)表面出现的可见渗出物或飞粉的现象。

3.6.1.7

法拉第笼效应 **Faraday cage effect**

由于带电搪瓷颗粒不能穿透凹陷区域而导致涂层较薄并产生焦斑(3.6.2.11)缺陷的现象。

3.6.1.8

轧制铁鳞 **mill scale**

某些金属在热轧或热处理过程中形成的厚氧化层。

3.6.1.9

氧化皮 scaling

金属表面形成的氧化层。

3.6.2 制品缺陷

3.6.2.1

针孔 pinhole

针眼 pinhole

瓷层(3.1.3.1)内气体逸出后未熔合的针状小孔。

3.6.2.2

爆瓷 chipping

烧成冷却后瓷层(3.1.3.1)表面出现的破裂和脱落。

3.6.2.3

爆点 jumpers;jumping

烧成时底釉(3.2.2.5)弹脱使基体金属(3.1.1.5)裸露的凹坑。

3.6.2.4

鱼鳞爆 fish scale

制品烧成冷却后瓷层(3.1.3.1)表面出现露底的鱼鳞状爆瓷。

3.6.2.5

过程鳞爆 process fish scaling

制品烘干或烧成过程中瓷层(3.1.3.1)表面出现的鱼鳞爆(3.6.2.4)现象。

3.6.2.6

星点鳞爆 shiner-scale

底釉层(3.1.3.3)由于过烧而呈现的密集、闪光且细小的鱼鳞爆(3.6.2.4)现象。

3.6.2.7

缺釉 lack of enamel

制品上的瓷层(3.1.3.1)缺损的现象。

3.6.2.8

剥瓷 peeling

大片的瓷层从基体金属(3.1.1.5)表面上脱落的现象。

3.6.2.9

裂纹 cracks

烧成后瓷层(3.1.3.1)表面受张应力作用而出现的裂隙。

3.6.2.10

线纹 hairline;strain line

瓷层(3.1.3.1)表面的发丝状纹路。

3.6.2.11

焦斑 burning-off

底釉层(3.1.3.3)或边釉层局部过烧形成的熔渣状斑痕。

3.6.2.12

发沸 boiling

烧成中因底釉层(3.1.3.3)的沸腾而在面釉层(3.1.3.4)表面出现聚集的气泡(3.6.2.15)、针孔(3.6.2.1)、

黑点(3.6.2.35)、坑(3.6.2.40)或海绵状的斑痕。

3.6.2.13

初沸 primary boiling

底釉层(3.1.3.3)首次烧成时由于气体逸出而呈现的发沸(3.6.2.12)现象。

3.6.2.14

再沸 reboiling

底釉层重复烧成时由于气泡逸出而呈现的发沸(3.6.2.12)现象。

3.6.2.15

气泡 blister; glass eye

瓷层(3.1.3.1)内因含有未逸出的气体而出现的突起泡粒。

3.6.2.16

缩烧 crawling; curling

烧成时瓷釉(3.1.1.4)收缩卷起而出现的不规则间隔的岛状现象。

3.6.2.17

撕裂 tearing

烧成时粉层(3.1.2.11)开裂,烧成后呈现的未愈合纹路。

3.6.2.18

砂眼 blowhole

因坯体焊接不当或瓷层(3.1.3.1)中含有粒状杂质在烧成过程中形成部分穿至基体金属(3.1.1.5)的孔眼。

3.6.2.19

发沸点 boiling spot

瓷釉(3.1.1.4)内混杂的有机物烧成后,在瓷层(3.1.3.1)表面呈现的无光或异色的发沸(3.6.2.12)状斑点。

3.6.2.20

过烧点 fire mark; over firing

因烧成过度瓷层(3.1.3.1)表面呈现的密集小点。

3.6.2.21

铜头 copperhead

烧成时基体钢板中熔出的氧化铁在底层中处于过饱和状态而析出的红褐色斑点。

3.6.2.22

弹点 pop-off

烧成时面釉层(3.1.3.4)弹脱使底釉层(3.1.3.3)裸露的点状凹痕。

3.6.2.23

铁屑 scale specking

烧成过程中瓷层(3.1.3.1)表面沾附的铁或铁基氧化夹杂物。

3.6.2.24

橘皮皱 orange peel

瓷层(3.1.3.1)表面呈现的橘皮状的不规则皱纹。

3.6.2.25

麻点 dimple; dent

瓷层(3.1.3.1)表面呈现的肤浅小凹坑。

3.6.2.26

失光 **chalky surface**

瓷层(3.1.3.1)表面呈粉状且光泽(3.5.3.6)极差的现象。

3.6.2.27

杂粒 **surface contaminate**

瓷层(3.1.3.1)表面沾附的颗粒状杂质。

3.6.2.28

露黑 **blue enamel**

面釉层(3.1.3.4)过薄或被擦损而出现的隐显底釉层(3.1.3.3)的黑影。

3.6.2.29

水印 **water line; water streak**

粉坯(3.1.2.4)或花坯(3.1.2.6)上残留的水迹经烧成后出现的印痕(3.6.2.51)。

3.6.2.30

异色 **contamination of waste enamel**

瓷层(3.1.3.1)表面沾附的不同于原有色泽的现象。

3.6.2.31

变形 **metal strain**

成型或烧成过程中,制品原有形状发生局部改变的现象。

3.6.2.32

工具痕 **tool mark**

成型或烧成工具在制品表面造成的明显印痕(3.6.2.51)。

3.6.2.33

边釉不齐 **irregular beading**

制品边部的面釉层(3.1.3.4)脱节呈锯齿形等的现象。

3.6.2.34

瓷面不匀 **inhomogeneous coating**

瓷层(3.1.3.1)表面出现梗状、块状、点状或波纹状等的瓷釉(3.1.1.4)堆积。

3.6.2.35

黑点 **black specks**

瓷层(3.1.3.1)表面的黑色斑点。

3.6.2.36

蚀刻 **etched**

由化学侵蚀而导致的表面失光(3.6.2.26)和/或表面粗糙。

3.6.2.37

珍珠线 **pearl lines**

丝网泡 **bubble lines**

在单线或一系列平行线上出现许多气泡(3.6.2.15)的缺陷。

3.6.2.38

焊接处泡孔 **metal blister**

在烧制过程中,因金属基体层间的气体使金属焊接处局部凸起,导致搪瓷表面出现的凸起状瑕疵。

3.6.2.39

猪皮皱 pig skin; leather

外观与猪皮纹理相似的表面缺陷。

3.6.2.40

坑 pit

表面小凹陷的缺陷。

3.6.2.41

孔隙 pore

烧制后,搪瓷(3.1.1.1)表面上穿透到金属基底的孔。

3.6.2.42

波纹 ripple

瓷层(3.1.3.1)表面出现的均匀、大范围的波浪状外观缺陷。

3.6.2.43

滑动 sliding

因釉浆(3.1.2.9)排浆(3.2.10.10)不良,导致釉浆层在自身重力作用下局部滑移产生的釉浆层不均匀的现象。

3.6.2.44

剥落 spall**脱落 spalling**

搪瓷(3.1.1.1)自发断裂和脱离导致的贝壳状断裂(有时可以看到基底)缺陷。

注:剥落通常发生在拐角、小半径或面板边缘区域,可能是由于搪瓷膨胀系数、外半径和相关搪瓷厚度过低造成的。机械应力和热应力会加剧剥落。

3.6.2.45

珠子 bead

通常在搪瓷浸渍(3.2.10.14)排浆(3.2.10.10)时,由于瓷釉(3.1.1.4)的积聚而引起的缺陷。

3.6.2.46

破气泡 break out

具有明确边界的开口气泡(3.6.2.15)。

3.6.2.47

流挂 curtains

流淌过程中出现的褶皱状缺陷。

3.6.2.48

凸块 lump

搪瓷表面上的块状凸起缺陷。

3.6.2.49

大理石效应 marble effect

在白色搪瓷表面产生的类似于杂色大理石的缺陷。

3.6.2.50

泛霜 scumming

在烧制的搪瓷表面上表现出失去光泽(3.5.3.6)的缺陷。

3.6.2.51

印痕 **star mark; spider**

在烧制过程中因粉层(3.1.2.11)损坏留下的蜘蛛形或星形的缺陷。

3.6.2.52

不连续性 **discontinuity**

通过电火花试验(3.7.4.3)检测出的瓷层(3.1.3.1)弱点。

3.6.2.53

流浆线 **drain line**

排浆(3.2.10.10)中形成的流线状缺陷。

3.6.2.54

下垂 **sagging**

扭曲 **distortion**

翘曲 **warping**

金属基材由于在自身重量下屈服和/或发生相变,导致坯体形状在烧成过程中永久变形的缺陷。

3.6.2.55

开裂 **dry crack**

由垂直于表面的熔融涂层中的层流中断引起的缺陷。

3.6.2.56

延迟鱼鳞爆 **delayed fish-scale**

冷却一段时间后出现鱼鳞爆(3.6.2.4)的现象。

3.6.2.57

波浪线纹 **shorelines**

在烧制的搪瓷表面上出现一系列大致同心的波浪线图案或纹理的缺陷。

3.6.2.58

过喷 **over-spray**

从喷枪(3.3.2.13)中喷出的釉料未能沉积到制品的目标区域。

3.6.2.59

反向发射 **back emission**

反电离 **back ionization**

因粉末层中的积累过多电荷导致空气发生电击穿(即反向发射)局部出现严重的橘皮皱(3.6.2.24)缺陷的现象。

注:这是静电粉末喷涂过程自身特性的影响产生的。

3.6.3 饰花缺陷术语

3.6.3.1

饰花模糊 **unclear decoration pattern**

饰花图案轮廓或线条不清晰的现象。

3.6.3.2

爆花 **chipping decoration**

饰花图案的色釉(3.2.2.2)开裂形成局部堆积的现象。

3.6.3.3

花模痕 **membrane—mark**

移花时在瓷层(3.1.3.1)表面留下的明显花模纸痕迹。

3.7 检测方法术语

3.7.1 熔块检测

3.7.1.1

熔流试验 **fusion flow test**

熔融成半球状的熔块(3.1.1.3)在倾斜一定角度的基板上经规定时间后以熔体流动的范围测定其相对熔流性(3.5.1.2)的试验。

3.7.1.2

自由滴重法 **free-fall method**

以丝状瓷釉(3.1.1.4)试样端部熔融时在表面张力作用下形成的液滴质量与受重力作用脱落的液滴质量相当原理测定表面张力的方法。

3.7.1.3

拉丝试验 **thread test**

在熔融过程中,从瓷釉(3.1.1.4)中拉出或抽出丝,通过检查是否存在未熔化颗粒来确定其熔化程度的试验。

3.7.2 釉浆、釉粉检测

3.7.2.1

筛分试验 **screen test**

用系列标准筛测定釉浆(3.1.2.9)、釉粉(3.1.2.10)粒度分布的试验。

3.7.2.2

塌落试验 **slump test**

按规定容积的釉浆(3.1.2.9)在平面上自由流动所铺展面的直径大小测定釉浆稠度(3.5.2.2)的试验。

3.7.2.3

沉降试验 **falling test**

在一组相同直径的试管中加入等量釉浆(3.1.2.9)经自然或离心沉降一定时间后,根据釉浆颗粒沉降状况测定悬浮性(3.5.2.3)的试验。

3.7.2.4

细度试验 **fineness test**

使用不同孔径的标准筛测定研磨后瓷釉(3.1.1.4)细度(3.5.2.1)的试验。

3.7.2.5

容重试验 **bulk density test**

测定瓷釉(3.1.1.4)单位体积质量的试验。

注:通常以 100 mL 釉浆(3.1.2.9)的质量表示。

3.7.3 制品检测

3.7.3.1

弯曲试验 cross-bend test

通过使搪瓷板弯曲变形来确定瓷层(3.1.3.1)的抗开裂性的方法。

3.7.3.2

落球试验 drop-ball test

用规定质量的钢球自一定高度自由下落冲击瓷层(3.1.3.1)表面或背面,根据瓷层破裂程度或底釉(3.1.3.3)层剥落状况测定瓷层耐冲击强度(3.5.3.9)或密着性(3.5.3.2)的方法。

3.7.3.3

探针试验 probe method

在搪瓷试样受外力作用的损伤处,根据探针的电流大小测定密着性(3.5.3.2)的方法。

3.7.3.4

研磨试验 grinding test

在规定的研磨条件下,根据瓷层磨损情况或失重测定耐磨性(3.5.3.10)的方法。

3.7.3.5

铅笔划痕试验 pencil test

在经受化学物质侵蚀的瓷层表面上用一定硬度的标准铅笔划痕,根据擦去铅笔痕迹的难易程度判断耐侵蚀性能的方法。

3.7.3.6

影像试验 reflection test

根据一定功率的白炽灯在经受化学物质侵蚀的瓷层表面的成像清晰度判断耐侵蚀性能的方法。

3.7.3.7

荧光示踪法 fluorescence trace method

以荧光物质作为示踪剂测定瓷层(3.1.3.1)表面可清洁性(3.5.3.8)的试验。

3.7.3.8

油滴氧化试验 self-clean

以一定量的精制豆油滴在自洁搪瓷(3.4.3.8)的试样表面上,加热后根据油滴的氧化挥发和扩散程度判断试样的自洁性能的方法。

3.7.3.9

热震试验 thermal shock test

温差急变试验

加热到规定温度的搪瓷试样经受冷水或冰水的急剧冷却,反复数次后,根据搪瓷表面被损坏前一次的温差,测定耐温急变性(3.5.3.12)的方法。

3.7.3.10

重金属析出试验 test for heavy metal release

在规定温度下用试液浸析瓷层中的镉、铅、镉等重金属物质并用原子吸收分光光度计等测定其含量的方法。

3.7.3.11

醋酸侵蚀试验 acetic acid etching test

规定浓度的醋酸液滴在室温下侵蚀搪瓷表面后,根据铅笔划痕试验或影像试验测定耐酸性

(3.5.3.13)的方法。

3.7.3.12

柠檬酸斑点试验 citric acid spot test

规定浓度的柠檬酸液滴在室温下侵蚀搪瓷表面后,根据铅笔划痕试验或影像试验测定耐酸性(3.5.3.13)的方法。

3.7.3.13

硫酸斑点试验 sulfuric acid spot test

规定浓度的硫酸液滴在室温下侵蚀瓷层表面后,根据铅笔划痕试验或影像试验测定耐酸性(3.5.3.13)的方法。

3.7.3.14

沸腾柠檬酸侵蚀试验 boiling citric acid etching test

试样浸入规定的沸腾柠檬酸溶液中延续一定时间,根据试样单位面积的失重量测定耐酸性(3.5.3.13)的方法。

3.7.3.15

沸腾盐酸侵蚀试验 boiling hydrochloric acid corrosion test

试样受规定浓度的沸腾盐酸腐蚀规定时间后,根据试样单位面积的失重量测定耐酸性(3.5.3.13)的方法。

3.7.3.16

碳酸钠溶液侵蚀试验 sodium carbonate etching test

用规定浓度的碳酸钠溶液侵蚀搪瓷表面一定时间,根据试样单位面积的失重量测定耐碱性(3.5.3.14)的方法。

3.7.3.17

焦磷酸钠溶液侵蚀试验 tetrasodium pyrophosphate etching test

搪瓷试样浸入规定浓度的沸腾焦磷酸钠溶液中一定时间,根据试样单位面积的失重量测定耐碱性(3.5.3.14)的方法。

3.7.3.18

热氢氧化钠溶液侵蚀试验 hot sodium hydroxide etching test

试样受规定浓度及温度的热氢氧化钠溶液,经腐蚀规定时间后,根据试样单位面积的失重量测定耐碱性(3.5.3.14)的方法。

3.7.3.19

沸水和水蒸气侵蚀试验 boiling water and water vapor etching test

搪瓷试样浸入沸水或暴露于水蒸气中一定时间,根据试样单位面积的失重量测定耐水性(3.5.3.15)的方法。

3.7.3.20

冲击试验 impact test

测试搪瓷承受冲击能力的试验。

3.7.3.21

海绵试验 sponge test

用于评估搪瓷连续性的低电压试验(3.7.4.2)。

3.7.3.22

拭子试验 swab test

用于评估搪瓷表面清洁度的试验。

3.7.4 缺陷检测

3.7.4.1

鳞爆倾向试验 test for fish scalindency

以电流作用下单位时间内通过铁坯试样表面的氢气体积测定瓷层鳞爆倾向的试验。

3.7.4.2

低电压试验 low voltage test

以浸渍(3.2.10.14)电解质(3.2.6.3)溶液的低电压探头检查搪瓷试样表面,根据电解质的颜色变化测定针孔(3.6.2.1)、裂纹(3.6.2.9)、砂眼(3.6.2.18)等缺陷的试验。

3.7.4.3

高电压试验 high voltage test

电火花试验 spark test

以高电压探头检查瓷层中真空及过薄区域的试验。

3.7.4.4

气密性试验 test for air-tightness

以气体为介质按一定的试验压力检测搪瓷设备气密性(3.5.3.19)的试验。

3.7.4.5

水压试验 hydraulic pressure test

以水为介质按一定的试验压力检测搪瓷设备强度及密封性能的方法。

附 录 A
(资料性)

本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况

表 A.1 给出了本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况。

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.1.1.1	3.255
3.1.1.2	—
3.1.1.3	3.124
3.1.1.4	3.255
3.1.1.5	3.242
3.1.1.6	—
3.1.2.1	—
3.1.2.2	3.22
3.1.2.3	—
3.1.2.4	—
3.1.2.5	—
3.1.2.6	—
3.1.2.7	—
3.1.2.8	3.227
3.1.2.9	3.223
3.1.2.10	—
3.1.2.11	3.20
3.1.2.12	3.177
3.1.2.13	3.179
3.1.2.14	—
3.1.2.15	—
3.1.2.16	3.228
3.1.2.17	—
3.1.2.18	—
3.1.2.19	—
3.1.2.20	3.111

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.1.2.21	—
3.1.3.1	—
3.1.3.2	—
3.1.3.3	—
3.1.3.4	—
3.1.3.5	—
3.1.3.6	3.30
3.1.4.1	—
3.1.4.2	—
3.1.4.3	—
3.1.5.1	3.103
3.1.5.2	3.104
3.1.5.3	3.105
3.1.5.4	3.47
3.1.5.5	—
3.1.5.6	3.69
3.2.1.1	—
3.2.1.2	3.121
3.2.1.3	3.158
3.2.1.4	—
3.2.1.5	—
3.2.1.6	3.49,3.167
3.2.1.7	3.12
3.2.1.8	3.73
3.2.1.9	3.19
3.2.1.10	3.154
3.2.1.11	3.171
3.2.1.12	3.201
3.2.1.13	3.211
3.2.1.14	3.148

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况（续）

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.2.2.1	3.45
3.2.2.2	3.50
3.2.2.3	3.159
3.2.2.4	3.190
3.2.2.5	3.135
3.2.2.6	3.59
3.2.2.7	3.18
3.2.3.1	—
3.2.3.2	—
3.2.3.3	—
3.2.4.1	—
3.2.4.2	—
3.2.4.3	—
3.2.4.4	—
3.2.5.1	—
3.2.5.2	—
3.2.5.3	—
3.2.5.4	—
3.2.5.5	—
3.2.5.6	—
3.2.5.7	—
3.2.5.8	—
3.2.6.1	3.150
3.2.6.2	3.218
3.2.6.3	—
3.2.6.4	3.241
3.2.6.5	3.43
3.2.7.1	3.89
3.2.7.2	—
3.2.7.3	3.6

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.2.8.1	—
3.2.8.2	—
3.2.8.3	3.62
3.2.8.4	—
3.2.8.5	—
3.2.8.6	—
3.2.8.7	—
3.2.8.8	—
3.2.9.1	3.44
3.2.9.2	3.166
3.2.9.3	3.127,3.155
3.2.9.4	—
3.2.9.5	—
3.2.9.6	3.23,3.205
3.2.9.7	3.1
3.2.9.8	—
3.2.9.9	—
3.2.9.10	3.48
3.2.9.11	3.134
3.2.9.12	3.252
3.2.10.1	3.90
3.2.10.2	—
3.2.10.3	—
3.2.10.4	3.100
3.2.10.5	—
3.2.10.6	3.119
3.2.10.7	—
3.2.10.8	3.101,3.102
3.2.10.9	3.81
3.2.10.10	3.87

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.2.10.11	—
3.2.10.12	3.256, 3.55
3.2.10.13	3.66
3.2.10.14	3.78
3.2.10.15	3.79
3.2.10.16	3.91
3.2.10.17	3.139
3.2.10.18	3.226
3.2.10.19	3.180
3.2.10.20	3.70
3.2.10.21	3.125
3.2.10.22	3.17
3.2.11.1	—
3.2.11.2	—
3.2.11.3	—
3.2.11.4	—
3.2.11.5	—
3.2.11.6	—
3.2.11.7	3.253
3.2.11.8	—
3.2.11.9	—
3.2.11.10	3.68
3.2.12.1	—
3.2.12.2	3.95
3.2.12.3	—
3.2.12.4	—
3.2.12.5	—
3.2.12.6	—
3.2.12.7	—
3.2.12.8	3.7

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.2.13.1	—
3.2.13.2	—
3.2.13.3	—
3.2.13.4	3.72
3.2.13.5	—
3.2.13.6	—
3.2.13.7	3.97
3.2.14.1	—
3.2.14.2	3.229
3.2.14.3	3.77
3.2.14.4	3.86
3.2.14.5	3.92
3.2.14.6	3.108
3.2.14.7	3.113
3.2.14.8	3.114
3.2.14.9	3.112
3.2.14.10	—
3.2.14.11	—
3.2.14.12	—
3.2.14.13	3.5
3.2.14.14	3.46
3.2.14.15	3.191
3.2.14.16	3.236
3.3.1.1	3.176
3.3.1.2	3.15
3.3.1.3	3.54
3.3.1.4	3.199
3.3.1.5	—
3.3.1.6	3.80
3.3.2.1	—

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.3.2.2	—
3.3.2.3	3.182
3.3.2.4	—
3.3.2.5	3.234
3.3.2.6	3.88
3.3.2.7	3.65
3.3.2.8	3.14
3.3.2.9	3.27
3.3.2.10	3.122
3.3.2.11	3.189
3.3.2.12	3.224
3.3.2.13	3.235
3.3.3.1	3.28
3.3.3.2	3.53
3.3.3.3	3.249
3.3.3.4	3.251
3.3.3.5	3.181
3.3.3.6	3.56
3.3.3.7	3.115
3.3.3.8	3.28, 3.153
3.3.4.1	—
3.3.4.2	3.123
3.3.4.3	3.32
3.3.4.4	3.71
3.3.4.5	3.164
3.3.4.6	—
3.3.4.7	3.98
3.3.4.8	3.165
3.3.4.9	3.248
3.4.1.1	3.157

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.4.1.2	3.156
3.4.1.3	—
3.4.1.4	—
3.4.1.5	3.84
3.4.1.6	3.250
3.4.2.1	—
3.4.2.2	3.36
3.4.2.3	3.57
3.4.2.4	3.10
3.4.2.5	—
3.4.3.1	3.147
3.4.3.2	—
3.4.3.3	—
3.4.3.4	—
3.4.3.5	—
3.4.3.6	—
3.4.3.7	—
3.4.3.8	—
3.4.3.9	3.213,3.186
3.4.4.1	—
3.4.4.2	3.206
3.4.4.3	—
3.4.4.4	3.142
3.4.4.5	—
3.4.4.6	—
3.4.4.7	—
3.4.4.8	—
3.4.4.9	3.138
3.4.4.10	—
3.4.5.1	3.214

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.4.5.2	3.152
3.4.5.3	3.216
3.4.5.4	3.38
3.4.5.5	3.96
3.4.5.6	3.178
3.4.5.7	3.187
3.5.1.1	—
3.5.1.2	—
3.5.2.1	—
3.5.2.2	3.51
3.5.2.3	—
3.5.2.4	3.217
3.5.2.5	3.120
3.5.2.6	3.197
3.5.2.7	3.246
3.5.2.8	3.254
3.5.3.1	3.52
3.5.3.2	3.4
3.5.3.3	—
3.5.3.4	3.60
3.5.3.5	—
3.5.3.6	3.131, 3.145
3.5.3.7	—
3.5.3.8	3.42
3.5.3.9	—
3.5.3.10	3.2
3.5.3.11	—
3.5.3.12	—
3.5.3.13	3.3
3.5.3.14	3.9

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.5.3.15	—
3.5.3.16	—
3.5.3.17	—
3.5.3.18	—
3.5.3.19	—
3.5.3.20	3.230
3.5.3.21	3.237
3.5.3.22	3.40
3.5.3.23	3.137
3.5.3.24	3.174
3.5.3.25	3.175
3.5.3.26	3.207
3.5.3.27	3.231
3.5.4.1	—
3.5.4.2	—
3.5.4.3	—
3.5.4.4	—
3.5.4.5	—
3.5.4.6	—
3.5.4.7	—
3.6.1.1	—
3.6.1.2	—
3.6.1.3	—
3.6.1.4	3.93
3.6.1.5	—
3.6.1.6	3.25
3.6.1.7	3.107
3.6.1.8	3.151
3.6.1.9	3.210
3.6.2.1	3.169

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.6.2.2	3.41
3.6.2.3	—
3.6.2.4	3.116
3.6.2.5	3.184
3.6.2.6	3.219
3.6.2.7	—
3.6.2.8	3.163
3.6.2.9	3.63
3.6.2.10	3.136
3.6.2.11	3.31
3.6.2.12	3.26
3.6.2.13	3.183
3.6.2.14	3.188
3.6.2.15	3.24, 3.130
3.6.2.16	3.62
3.6.2.17	3.245
3.6.2.18	—
3.6.2.19	—
3.6.2.20	3.110
3.6.2.21	3.58
3.6.2.22	3.172
3.6.2.23	3.209
3.6.2.24	3.160
3.6.2.25	3.76
3.6.2.26	3.94
3.6.2.27	—
3.6.2.28	—
3.6.2.29	—
3.6.2.30	—
3.6.2.31	—

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.6.2.32	—
3.6.2.33	—
3.6.2.34	—
3.6.2.35	3.21
3.6.2.36	3.106
3.6.2.37	3.162
3.6.2.38	3.143,3.149
3.6.2.39	3.168
3.6.2.40	3.170
3.6.2.41	3.173
3.6.2.42	3.198
3.6.2.43	3.222,3.204
3.6.2.44	3.232
3.6.2.45	3.16
3.6.2.46	3.29
3.6.2.47	3.67
3.6.2.48	3.144
3.6.2.49	3.146
3.6.2.50	3.212
3.6.2.51	3.238
3.6.2.52	3.82
3.6.2.53	3.85
3.6.2.54	3.203
3.6.2.55	3.61
3.6.2.56	3.74
3.6.2.57	3.220
3.6.2.58	3.161
3.6.2.59	3.13
3.6.3.1	—
3.6.3.2	—

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.6.3.3	—
3.7.1.1	3.33,3.126
3.7.1.2	—
3.7.1.3	3.247
3.7.2.1	—
3.7.2.2	3.225
3.7.2.3	—
3.7.2.4	3.109
3.7.2.5	—
3.7.3.1	3.64
3.7.3.2	—
3.7.3.3	—
3.7.3.4	—
3.7.3.5	—
3.7.3.6	—
3.7.3.7	—
3.7.3.8	—
3.7.3.9	—
3.7.3.10	—
3.7.3.11	—
3.7.3.12	—
3.7.3.13	—
3.7.3.14	—
3.7.3.15	—
3.7.3.16	—
3.7.3.18	—
3.7.3.19	—
3.7.3.20	3.140
3.7.3.21	3.243
3.7.3.22	3.244

表 A.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的结构编号对照情况（续）

本文件结构编号	ISO 19496-1:2017 结构编号
3.7.4.1	—
3.7.4.2	—
3.7.4.3	3.233
3.7.4.4	—
3.7.4.5	—
—	3.8,3.11,3.34,3.35,,3.37,3.39,3.75,3.83,3.99,3.117,3.118,3.128,3.129, 3.132,3.133,3.141,3.185,3.192,3.193,3.194,3.195,3.196,3.200,3.202,3.208, 3.215,3.221,3.239,3.240,3.257,3.258,3.259,3.260
—	附录 A

附 录 B

(资料性)

本文件与 ISO 19496-1:2017 的技术差异及其原因

表 B.1 给出了本文件与 ISO 19496-1:2017 的技术差异及其原因的一览表。

表 B.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的技术差异及其原因

本文件结构编号	技术差异	原因
3.1.1	增加了搪玻璃/工业搪瓷、坯体的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.1.2	增加了金属坯料、金属坯体、粉坯、素坯、花坯、配合料、釉粉、搪瓷制品、搪玻璃设备、表面处理、涂搪、饰花、返修的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.1.3	增加了瓷层、搪玻璃层、底釉层、面釉层、密着层的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.1.4	增加了熔炉、烧成炉、烧成工具的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.1.5	增加了热轧钢的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.1	增加了基体剂、密着剂、氧化剂的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.3	增加了镍底釉、钴底釉、铋钨底釉的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.4	增加了钛白釉、钛彩釉、铋白釉、锆白釉的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.5	增加了搪玻璃釉、耐酸釉、耐碱釉、低温釉、发光釉、铸铁瓷釉、铝搪瓷釉、铜搪瓷釉的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.6	增加了电解质的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.7	增加了湿磨的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.8	增加了切片、冲压、拉胖/胀径、收口、平皱/研光、割口、磨光的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.9	增加了预烧、光亮退火、中和、电解酸洗的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.10	增加了湿法涂搪、浸渍涂搪、浇注涂搪、真空涂搪、滚边的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致

表 B.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的技术差异及其原因 (续)

本文件结构编号	技术差异	原因
3.2.11	增加了印花、喷花、移花、刷花、堆花、洒冰花、描金、照相饰花的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.12	增加了烘干、直接火烧成、间接火烧成、感应烧成、辐射管烧成、烧花的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.13	增加了补粉、回烧、修补、补烧架印、磨修的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.2.14	增加了熔化温度、重新升温时间、输送链速度、瓷层厚度的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.3.1	增加了电熔炉的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.3.2	增加了涂搪机、打印滚边机、浸渍缸的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.3.4	增加了烧车、吊架的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.4.1	增加了面釉单搪制品、面釉双搪制品的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.4.2	增加了钢板搪瓷、不锈钢搪瓷的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.4.3	增加了微晶搪瓷、吸热搪瓷、发光搪瓷、无光搪瓷、医疗生化搪瓷、纤维增强搪瓷、自洁搪瓷的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.4.4	增加了日用搪瓷、建筑搪瓷、标牌搪瓷、搪玻璃容器、搪玻璃压力容器、搪玻璃反应罐、拼装罐的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.5.1	增加了熔度、熔流性的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.5.2	增加了细度、悬浮性的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.5.3	增加了残余应力、乳浊度、白度、耐冲击强度、耐热性、耐温急变性、耐水性、耐压性、耐冷冲击性、耐热冲击性、气密性的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.5.4	增加了 3.5.4, 搅拌器上端径向跳动、搅拌器下端径向跳动、温度计套管直线度、法兰压紧面宽度、法兰平面度、搅拌孔法兰平行度、支座对中性的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.6.1	增加了瘪、坯体皱裯、缺粉、锈点的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致

表 B.1 本文件与 ISO 19496-1:2017 的技术差异及其原因 (续)

本文件结构编号	技术差异	原因
3.6.2	增加了爆点、缺釉、砂眼、发沸点、杂粒、露黑、水印、异色、变形、工具痕、边釉不齐、瓷面不匀的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.6.3	增加了饰花模糊、爆花、花模痕的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.7.1	增加了自由滴重法的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.7.2	增加了筛分试验、沉降试验、容重试验的术语和定于	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.7.3	增加了落球试验、探针试验、研磨试验、铅笔划痕试验、影像试验、荧光示踪法、油滴氧化试验、热震试验/温差急变试验、重金属析出试验、醋酸侵蚀试验、柠檬酸斑点试验、硫酸斑点试验、沸腾柠檬酸侵蚀试验、沸腾盐酸侵蚀试验、碳酸钠溶液侵蚀试验、焦磷酸钠溶液侵蚀试验、热氢氧化钠溶液侵蚀试验、沸水和水蒸气侵蚀试验的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
3.7.4	增加了鳞爆倾向试验、低电压试验、气密性试验、水压试验的术语和定义	适应我国产业技术现状,与我国相关标准协调一致
索引	增加了术语的汉语拼音索引和英文对应词索引	便于使用,并符合我国标准编写要求
—	删除了碱脱脂、退火、碳沸腾、流挂、金属陶瓷/陶瓷-金属涂层、失光表面、晶化、二次排浆、蛋壳面、缺陷、熔球、加斯图拉/放气缺陷/发灰/海绵状珐琅、玻璃、纹理、压纹辊、罐磨机、焦酚、还原镍浸/自催化镍浸/化学镀镍浸、反射率、反射率、耐火复合涂层、电阻率、磨石、垂度试验、凸包、半马弗炉、银钢、斑点装饰、石磨、鲸鱼鳞爆、水膜破裂试验、水印/水斑/水渍、水纹/水线的术语和定义	行业无相应需求,不适用于我国行业现状
—	删除了附录 A 替代术语对照索引	不适用

索 引

汉语拼音索引

B		瓷层·····	3.1.3.1
		瓷层厚度·····	3.2.14.12
白度·····	3.5.3.7	瓷层连续性·····	3.5.3.1
半透明搪瓷·····	3.4.5.3	瓷面不匀·····	3.6.2.34
爆瓷·····	3.6.2.2	瓷釉·····	3.1.1.4
爆点·····	3.6.2.3	醋酸侵蚀试验·····	3.7.3.11
爆花·····	3.6.3.2	催化自洁搪瓷·····	3.4.3.9
边部涂搪·····	3.2.10.22	D	
边釉·····	3.2.2.7	打印滚边机·····	3.3.2.2
边釉不齐·····	3.6.2.33	大理石效应·····	3.6.2.49
变形·····	3.6.2.31	带罐喷枪·····	3.3.2.7
标牌搪瓷·····	3.4.4.5	弹点·····	3.6.2.22
表面处理·····	3.1.2.17	低电压试验·····	3.7.4.2
瘪·····	3.6.1.1	低温釉·····	3.2.5.4
波浪线纹·····	3.6.2.57	底釉·····	3.2.2.5
波纹·····	3.6.2.42	底釉层·····	3.1.3.3
剥瓷·····	3.6.2.8	电火花试验·····	3.7.4.3
剥落·····	3.6.2.44	电解酸洗·····	3.2.9.9
补粉·····	3.2.13.1	电解质·····	3.2.6.3
补烧架印·····	3.2.13.5	电熔炉·····	3.3.1.5
不连续性·····	3.6.2.52	电泳涂搪·····	3.2.10.4
不锈钢搪瓷·····	3.4.2.5	吊架·····	3.3.4.6
C		堆花·····	3.2.11.5
残余应力·····	3.5.3.3	多层烧架·····	3.3.4.4
沉降试验·····	3.7.2.3	F	
陈化·····	3.2.7.3	发沸·····	3.6.2.12
冲击试验·····	3.7.3.20	发沸点·····	3.6.2.19
冲压·····	3.2.8.2	发光搪瓷·····	3.4.3.4
重新升温时间·····	3.2.14.10	发光釉·····	3.2.5.5
稠度·····	3.5.2.2	法拉第笼效应·····	3.6.1.7
初沸·····	3.6.2.13	法兰平面度·····	3.5.4.5
除瓷·····	3.2.13.4	法兰压紧面宽度·····	3.5.4.4
触变性·····	3.5.2.7	珐琅·····	3.1.1.1
传统涂搪·····	3.2.10.12	反电离·····	3.6.2.59
炊具·····	3.4.4.9		

反向发射	3.6.2.59	过烧点	3.6.2.20
返修	3.1.2.21		
泛霜	3.6.2.50		
防锈剂	3.2.1.12		
沸水和水蒸气侵蚀试验	3.7.3.19		
沸腾柠檬酸侵蚀试验	3.7.3.14		
沸腾盐酸侵蚀试验	3.7.3.15		
粉层	3.1.2.11		
粉层强度	3.2.14.6		
粉化	3.6.1.6		
粉末-粉末涂搪	3.2.10.19		
粉末粘附力	3.2.14.13		
粉坯	3.1.2.4		
粉涂	3.2.12.2		
辐射管烧成	3.2.12.6		
辐射管烧成炉	3.3.3.3		
福特杯	3.3.2.10		

G

坩埚炉	3.3.1.1
干法涂搪	3.2.10.1
干法铸铁搪瓷粉	3.1.2.13
干粉蘸涂	3.2.10.15
干裂	3.6.1.4
干磨	3.2.7.1
干喷	3.2.10.16
干重	3.2.14.5
感应烧成	3.2.12.5
钢板搪瓷	3.4.2.1
高电压试验	3.7.4.3
铅白釉	3.2.4.4
割口	3.2.8.7
工具痕	3.6.2.32
工业搪瓷	3.1.1.2
钴底釉	3.2.3.2
光洁度	3.5.3.26
光亮退火	3.2.9.5
光泽	3.5.3.6
滚边	3.2.10.11
过程鳞爆	3.6.2.5
过喷	3.6.2.58

J

基体剂	3.2.1.1
基体金属	3.1.1.5
间接火烧成	3.2.12.4
间歇式熔炉	3.3.1.2
剪卷	3.2.8.3
建筑搪瓷	3.4.4.3
浇搪	3.2.10.18
浇釉	3.2.10.13
浇注涂搪	3.2.10.5
焦斑	3.6.2.11
焦磷酸钠溶液侵蚀试验	3.7.3.17
搅拌孔法兰平行度	3.5.4.6
搅拌器上端径向跳动	3.5.4.1
搅拌器下端径向跳动	3.5.4.2
解凝剂	3.2.1.8
介质	3.2.1.14
金属毛坯	3.1.2.2
金属坯料	3.1.2.1
金属坯体	3.1.2.3
浸渍	3.2.10.14
浸渍缸	3.3.2.4
浸渍量	3.2.14.3

浸渍涂搪	3.2.10.3
静电干粉	3.1.2.12
静电搪瓷	3.4.5.6
静电涂搪	3.2.10.8
橘皮皱	3.6.2.24

K

开裂	3.6.2.55
抗菌剂	3.2.1.9
抗氧化剂	3.2.1.7
烤箱用制品	3.4.4.9
可清洁性	3.5.3.8
可染性	3.5.3.21
坑	3.6.2.40
孔刷	3.3.2.9
孔隙	3.6.2.41
孔隙率	3.5.3.25

L

拉胖	3.2.8.4
拉丝试验	3.7.1.3
老化	3.2.7.3
冷却区	3.3.3.6
冷轧钢	3.1.5.4
连续烧成炉	3.3.3.2
连续式熔炉	3.3.1.3
两搪一烧制品	3.4.1.6
裂纹	3.6.2.9
鳞爆倾向试验	3.7.4.1
零碳钢	3.1.5.6
流变性	3.5.2.6
流动涂搪	3.2.10.6
流动性	3.5.2.5
流挂	3.6.2.47
流浆时间	3.2.14.4
流浆线	3.6.2.53
硫酸斑点试验	3.7.3.13
露黑	3.6.2.28
落球试验	3.7.3.2
铝搪瓷釉	3.2.5.7
铝搪瓷	3.4.2.4

M

麻点	3.6.2.25
马弗炉	3.3.3.8
密着层	3.1.3.5
密着剂	3.2.1.4
密着性	3.5.3.2
面釉	3.2.2.6
面釉层	3.1.3.4
面釉单搪制品	3.4.1.3
面釉双搪制品	3.4.1.4
描金	3.2.11.8
磨光	3.2.8.8
磨加物	3.2.6.1
磨修	3.2.13.6

N

耐冲击强度	3.5.3.9
耐化学性	3.5.3.22
耐碱性	3.5.3.14
耐碱釉	3.2.5.3
耐冷冲击性	3.5.3.17
耐磨性	3.5.3.10
耐热冲击性	3.5.3.18
耐热性	3.5.3.11
耐熔性	3.5.3.23
耐水性	3.5.3.15
耐酸性	3.5.3.13
耐酸釉	3.2.5.2
耐温急变性	3.5.3.12
耐压性	3.5.3.16
黏度	3.5.2.8
镍底釉	3.2.3.1
柠檬酸斑点试验	3.7.3.12
扭曲	3.6.2.54

P

排浆	3.2.10.10
抛丸	3.2.9.11
配合料	3.1.2.7
配色	3.2.9.10

喷花	3.2.11.2	熔块	3.1.1.3
喷磨	3.2.9.7	熔流试验	3.7.1.1
喷枪	3.3.2.13	熔流性	3.5.1.2
喷砂	3.2.9.6	熔炉	3.1.4.1
喷涂室	3.3.2.5	熔体	3.1.2.8
喷雾速率	3.2.14.16	熔制	3.1.2.16
喷影光	3.2.11.7	容重试验	3.7.2.5
膨胀系数	3.2.14.14	乳浊度	3.5.3.5
坯体	3.1.1.6	乳浊剂	3.2.1.3
坯体皱裯	3.6.1.2	乳浊釉	3.2.2.3
披镍	3.2.9.3	软化温度	3.2.14.2
拼装罐	3.4.4.10	S	
平皱	3.2.8.6		
破气泡	3.6.2.46	洒冰花	3.2.11.6
Q		洒粉筛子	3.3.2.6
		三角烧架	3.3.4.9
气封	3.2.12.8	色釉	3.2.2.2
气孔率	3.5.3.24	砂眼	3.6.2.18
气密性	3.5.3.19	筛分试验	3.7.2.1
气密性试验	3.7.4.4	烧叉	3.3.4.2
气幕	3.2.12.8	烧车	3.3.4.1
气泡	3.6.2.15	烧成	3.1.2.20
气泡结构	3.1.3.6	烧成幅度	3.2.14.9
铅笔划痕试验	3.7.3.5	烧成工具	3.1.4.3
翘曲	3.6.2.54	烧成炉	3.1.4.2
切片	3.2.8.1	烧成区	3.3.3.7
球磨机	3.3.2.8	烧成时间	3.2.14.8
去边釉	3.2.10.20	烧成温度	3.2.14.7
缺粉	3.6.1.3	烧花	3.2.12.7
缺釉	3.6.2.7	烧架	3.3.4.3
R		烧架支撑点	3.3.4.3
		烧架支撑杆	3.3.4.3
热氢氧化钠溶液侵蚀试验	3.7.3.18	失光	3.6.2.26
热洒涂	3.2.10.17	湿法涂搪	3.2.10.2
热轧钢	3.1.5.5	湿磨	3.2.7.2
热震试验	3.7.3.9	蚀刻	3.6.2.36
日用搪瓷	3.4.4.1	饰花	3.1.2.19
日用制品	3.4.4.9	饰花模糊	3.6.3.1
溶解性	3.5.3.27	拭子试验	3.7.3.22
熔度	3.5.1.1	收口	3.2.8.5
熔化温度	3.2.14.1	书写板搪瓷	3.4.5.4

梳齿支架	3.3.4.5	停留性	3.5.2.4
输送链速度	3.2.14.11	铜搪瓷	3.4.2.3
刷花	3.2.11.4	铜搪瓷釉	3.2.5.8
双面搪瓷制品	3.4.1.5	铜头	3.6.2.21
水压试验	3.7.4.5	透明釉	3.2.2.1
水印	3.6.2.29	凸块	3.6.2.48
丝网泡	3.6.2.37	涂搪	3.1.2.18
丝网油墨	3.2.1.13	涂搪机	3.3.2.1
撕裂	3.6.2.17	脱落	3.6.2.44
素坯	3.1.2.5	脱碳钢	3.1.5.6
酸浸筐	3.3.4.8	脱脂	3.2.9.1
酸洗	3.2.9.2		
缩烧	3.6.2.16		
T			
塌落试验	3.7.2.2	弯曲试验	3.7.3.1
钛白釉	3.2.4.1	网印油墨	3.2.1.13
钛彩釉	3.2.4.2	微晶搪瓷	3.4.3.2
探针试验	3.7.3.3	卫浴搪瓷	3.4.4.2
碳酸钠溶液侵蚀试验	3.7.3.16	温差急变试验	3.7.3.9
搪玻璃	3.1.1.2	温度计套管直线度	3.5.4.3
搪玻璃层	3.1.3.2	无光搪瓷	3.4.3.5
搪玻璃反应罐	3.4.4.8		
搪玻璃容器	3.4.4.6	X	
搪玻璃设备	3.1.2.15	吸热搪瓷	3.4.3.3
搪玻璃压力容器	3.4.4.7	细度	3.5.2.1
搪玻璃釉	3.2.5.1	细度试验	3.7.2.4
搪瓷	3.1.1.1	下垂	3.6.2.54
搪瓷钢板	3.1.5.3	纤维增强搪瓷	3.4.3.7
搪瓷铝	3.1.5.1	线纹	3.6.2.10
搪瓷制品	3.1.2.14	箱式烧成炉	3.3.3.1
搪瓷铸铁	3.1.5.2	星点鳞爆	3.6.2.6
陶瓷油墨	3.2.1.13	修边	3.2.13.7
锑白釉	3.2.4.3	修边刷	3.3.4.7
锑钼底釉	3.2.3.3	修补	3.2.13.3
填充料	3.2.1.11	锈点	3.6.1.5
填料	3.2.1.11	悬浮剂	3.2.6.4
调墨油	3.2.11.5	悬浮性	3.5.2.3
贴花纸	3.2.11.10		
铁屑	3.6.2.23	Y	
停留剂	3.2.6.2	压力罐	3.3.2.3
		研光	3.2.8.6
		哑光搪瓷	3.4.3.1

延迟鱼鳞爆	3.6.2.56	胀径	3.2.8.4
研磨试验	3.7.3.4	照相饰花	3.2.11.9
氧化剂	3.2.1.5	遮盖力	3.5.3.4
氧化皮	3.6.1.9	珍宝搪瓷	3.4.4.4
一次烧成制品	3.4.1.1	珍珠线	3.6.2.37
一次搪瓷制品	3.4.1.2	针孔	3.6.2.1
医疗生化搪瓷	3.4.3.6	针眼	3.6.2.1
移花	3.2.11.3	真空涂搪	3.2.10.7
异色	3.6.2.30	蒸汽脱脂	3.2.9.12
易清洁搪瓷	3.4.5.5	支座对中性	3.5.4.7
易污性	3.5.3.20	直接火烧成	3.2.12.3
印痕	3.6.2.51	直接烧成炉	3.3.1.6
印花	3.2.11.1	直接涂搪	3.2.10.9
荧光示踪法	3.7.3.7	中和	3.2.9.8
影像试验	3.7.3.6	中和剂	3.2.1.10
油滴氧化试验	3.7.3.8	中空制品	3.4.4.9
釉粉	3.1.2.10	重金属析出试验	3.7.3.10
釉浆	3.1.2.9	珠子	3.6.2.45
釉浆稠度计	3.3.2.12	猪皮皱	3.6.2.39
鱼鳞爆	3.6.2.4	助熔剂	3.2.1.2
预处理剂	3.2.6.5	铸铁瓷釉	3.2.5.6
预磨粉	3.4.5.7	铸铁搪瓷	3.4.2.2
预热区	3.3.3.5	转移花纸	3.2.11.10
预烧	3.2.9.4	着色剂	3.2.1.6
		自洁搪瓷	3.4.3.8
		自由滴重法	3.7.1.2
		自着色搪瓷	3.4.5.1
		ETC 搪瓷	3.4.5.5
		RTU 搪瓷	3.4.5.7
		U 形烧成炉	3.3.3.4

Z

杂粒	3.6.2.27
再沸	3.6.2.14
再循环浸渍缸	3.3.2.11
造粒	3.2.10.21
轧制铁鳞	3.6.1.8

英文对应词索引

A

abrasion resistance	3.5.3.10
abrasive blasting	3.2.9.7
acid resistance	3.5.3.13
acid resistant enamel	3.2.5.2
acetic acid etching test	3.7.3.11

adherence	3.5.3.2
adhesion of powder	3.2.14.13
adhesive agent	3.2.1.4
adhesive layer	3.1.3.5
ageing	3.2.7.3
aging	3.2.7.3
air curtain	3.2.12.8
air seal	3.2.12.8
air tightness	3.5.3.19
alkali resistance	3.5.3.14
alkali resistant enamel	3.2.5.3
aluminum enamel	3.2.5.7, 3.4.2.4
annealing	3.2.9.4
antimony enamel	3.2.4.3
antimony—molybdenum enamel	3.2.3.3
anti-scale compound	3.2.1.7
application	3.1.2.18
architectural enamel	3.4.4.3

B

back emission	3.6.2.59
back ionization	3.6.2.59
ball mill	3.3.2.8
base stock	3.2.1.1
base substrate	3.1.1.6
batch	3.1.2.7
batch smelter	3.3.1.2
bead	3.6.2.45
bead enameling	3.2.10.11
beading	3.2.10.22
beading enamel	3.2.2.7
biocide	3.2.1.9
biscuit strength	3.2.14.6
bisque	3.1.2.11
bisque body	3.1.2.4
black specks	3.6.2.35
blackboard enamel	3.4.5.4
blank	3.1.2.2
blanking diskling	3.2.8.1
blister	3.6.2.15
blowhole	3.6.2.18

bloom	3.6.1.6
blue enamel	3.6.2.28
boiling	3.6.2.12
boiling citric acid etching test	3.7.3.14
boiling hydrochloric acid corros ion test	3.7.3.15
boiling spot	3.6.2.19
boiling water and water vapor etching test	3.7.3.19
boiling water or water vapor resistance	3.5.3.15
bolt-hole brush	3.3.2.9
bolted vitreous and porcelain enamelled steel tanks	3.4.4.10
box furnace	3.3.3.1
break out	3.6.2.46
bright-annealing	3.2.9.5
brush-decoration	3.2.11.4
bubble lines	3.6.2.37
bubble structure	3.1.3.6
buck	3.3.4.3
bulging	3.2.8.4
bulk density test	3.7.2.5
burning	3.1.2.20
burning bar	3.3.4.3
burning-off	3.6.2.11
burning point	3.3.4.3
burning tool	3.3.4.3

C

cast iron enamel	3.4.2.2
catalytic enamel	3.4.3.9
centering of gearbox supports	3.5.4.7
ceramic—glass enamel	3.4.3.2
ceramic ink	3.2.1.13
chain speed	3.2.14.11
chalkboard enamel	3.4.5.4
chalky surface	3.6.2.26
chemical resistance	3.5.3.22
chipping	3.6.2.2
chipping decoration	3.6.3.2
citric acid spot test	3.7.3.12
cleanability	3.5.3.8
cleaner	3.2.6.5
coating thickness	3.2.14.12

cobalt enamel	3.2.3.2
coefficient of expansion	3.2.14.14
cold-rolled steel	3.1.5.4
colored frit	3.2.2.2
colorant	3.2.1.6
colour matching	3.2.9.10
colored titanium enamel	3.2.4.2
comb—rack	3.3.4.5
comeback	3.2.14.10, 3.2.14.15
concavity	3.6.1.1
consistency	3.5.2.2
contamination of waste enamel	3.6.2.30
continuity of coating	3.5.3.1
continuous furnace	3.3.3.2
continuous smelter	3.3.1.3
conventional enameling	3.2.10.12
cookware	3.4.4.9
cooling zone	3.3.3.6
copper enamel	3.2.5.8, 3.4.2.3
copperhead	3.6.2.21
cover coat	3.1.3.4
cover-coat enamel	3.2.2.6
covering power	3.5.3.4
cracks	3.6.2.9
crawling	3.6.2.16
cross-bend test	3.7.3.1
cup spray gun	3.3.2.7
cupping	3.2.10.13
curing	3.2.8.3
curling	3.6.2.16
curtains	3.6.2.47

D

de-beading	3.2.10.20
decal	3.2.11.10
decarburized steel	3.1.5.6
decking	3.3.4.4
decorate fire	3.2.12.7
decorated ware	3.1.2.6
decorating fire	3.2.12.7
decoration	3.1.2.19

de-enameling	3.2.13.4
deep drawing	3.2.8.2
degreasing	3.2.9.1
delayed fish-scale	3.6.2.56
dent	3.6.2.25
de-setting agent	3.2.1.8
dial shake of lower end of agitator	3.5.4.2
dimple	3.6.2.25
dip tank	3.3.2.4
dipping	3.2.10.14, 3.2.10.15
dipping enameling	3.2.10.3
direct fired furnace	3.3.1.6
direct firing	3.2.12.3
direct-on-enameling	3.2.10.9
discontinuity	3.6.2.52
discontinuous smelter	3.3.1.2
distortion	3.6.2.54
domestic enamel	3.4.4.1
double ware	3.4.1.5
drain line	3.6.2.53
drain process	3.2.10.10
drain time	3.2.14.4
draining enameling	3.2.10.6
dredge	3.3.2.6
dredging enameling	3.2.10.1
drop-ball test	3.7.3.2
dry crack	3.6.2.55
dry grinding	3.2.7.1
dry process enameling	3.2.10.1
dry spray	3.2.10.16
dry weight	3.2.14.5
drying	3.2.12.1
drying crack	3.6.1.4
dust coat	3.2.12.2

E

easy-to-clean enamel	3.4.5.5
eat-absorbing enamel	3.4.3.3
edging	3.2.13.7
edging brush	3.3.4.7
edge trimming	3.2.8.7

electric melting furnace	3.3.1.5
electrolysis pickling	3.2.9.9
electrolyte	3.2.6.3
electrophoresis enameling	3.2.10.4
electrostatic enamel	3.4.5.6
electrostatic enameling	3.2.10.8
electrostatic powder	3.1.2.12
enamel	3.1.1.1, 3.1.1.4
enamel coating	3.1.3.1
enamel for glassed steel	3.2.5.1
enamel product	3.1.2.14
enameling	3.1.2.18
enameling aluminum	3.1.5.1
enameling cast iron	3.1.5.2
enameling steel	3.1.5.3
ETC enamel	3.4.5.5
etched	3.6.2.36

F

falling test	3.7.2.3
Faraday cage effect	3.6.1.7
fiber—reinforced enamel	3.4.3.7
filler	3.2.1.11
filling decoration	3.2.11.5
fineness	3.5.2.1
fineness test	3.7.2.4
finishing	3.2.8.8
fire mark	3.6.2.20
firing	3.1.2.20
firing range	3.2.14.9
firing temperature	3.2.14.7
firing time	3.2.14.8
firing tools	3.1.4.3
firing zone	3.3.3.7
fish scale	3.6.2.4
fluidity	3.5.2.5
fluorescence trace method	3.7.3.7
flux	3.2.1.2
ford cup	3.3.2.10
fork	3.3.4.2
fork truck	3.3.4.1

free-fall method	3.7.1.2
frit	3.1.1.3
fritting	3.2.10.21
furnace	3.1.4.2
fusibility	3.5.1.1
fusion flow	3.5.1.2
fusion flow test	3.7.1.1

G

glass coated steel	3.1.1.2
glass eye	3.6.2.15
glassed steel	3.1.1.2
glassed steel chemical reactor	3.4.4.8
glassed steel equipment	3.1.2.15
glassed steel pressure—vessels	3.4.4.7
glassed steel vessels	3.4.4.6
glass-lined coating	3.1.3.2
glass-lined steel	3.1.1.2
gloss	3.5.3.6
gold depicting	3.2.11.8
graniteware	3.4.5.2
grinding test	3.7.3.4
grit blasting	3.2.9.11
ground coat	3.1.3.3
ground-coat enamel	3.2.2.5

H

hairline	3.6.2.10
hanging racks	3.3.4.6
hardness	3.5.3.23
heat resistance	3.5.3.11
high voltage test	3.7.4.3
hollowware	3.4.4.9
hot dusting	3.2.10.17
hot-rolled steel	3.1.5.5
hot sodium hydroxide etching test	3.7.3.18
hydraulic pressure test	3.7.4.5

I

impact resistance	3.5.3.9
impact test	3.7.3.20

indirect firing	3.2.12.4
induction firing	3.2.12.5
inhomogeneous coating	3.6.2.34
irregular beading	3.6.2.33

J

jewelers enamel	3.4.4.4
jumpers	3.6.2.3
jumping	3.6.2.3

L

lack of bisque	3.6.1.3
lack of enamel	3.6.2.7
leather	3.6.2.39
low temperature enamel	3.2.5.4
low voltage test	3.7.4.2
luminescent enamel	3.4.3.4
luminous enamel	3.2.5.5
lump	3.6.2.48

M

machine for enameling	3.3.2.1
machine for stamping and edging	3.3.2.2
marble effect	3.6.2.49
matt enamel	3.4.3.1, 3.4.3.5
medical and biochemical enamel	3.4.3.6
medium	3.2.1.14
melter	3.1.4.1
melting	3.1.2.16
melting temperature	3.2.14.1
membrane—mark	3.6.3.3
metal blank	3.1.2.1
metal blister	3.6.2.38
metal body	3.1.2.3
metal strain	3.6.2.31
mill addition	3.2.6.1
mill scale	3.6.1.8
mottled enamel	3.4.5.2
muffle furnace	3.3.3.8

N

necking	3.2.8.5
---------------	---------

neutralization	3.2.9.8
neutralizer	3.2.1.10
nickel dipping	3.2.9.3
nickel enamel	3.2.3.1

O

one-coat ware	3.4.1.2
one-cover-coat ware	3.4.1.3
one-fire finish	3.4.1.1
opacifier	3.2.1.3
opacity	3.5.3.5
opaque frit	3.2.2.3
orange peel	3.6.2.24
ovenware	3.4.4.9
over-spray	3.6.2.58
over firing	3.6.2.20
oxidizer	3.2.1.5

P

parallelism of agitator—hole flanges	3.5.4.6
patching of firing tool marks	3.2.13.5
pearl lines	3.6.2.37
peeling	3.6.2.8
pencil test	3.7.3.5
perpendicularity of thermowell	3.5.4.3
photographic decoration	3.2.11.9
pickle basket	3.3.4.8
pickling	3.2.9.2
pig skin	3.6.2.39
pinhole	3.6.2.1
pit	3.6.2.40
planeness of flange	3.5.4.5
plate weight	3.2.14.3
plugging compound	3.2.1.11
poling decoration	3.2.11.5
pop-off	3.6.2.22
porcelain enamel	3.1.1.1
pore	3.6.2.41
porosity	3.5.3.24, 3.5.3.25
pot furnace	3.3.1.1
powdered enamel	3.1.2.13

powdered frit	3.1.2.10
powder-powder enameling	3.2.10.19
pre-burning	3.2.9.4
preheat zone	3.3.3.5
pressure resistance	3.5.3.16
pressure tank	3.3.2.3
primary boiling	3.6.2.13
printing	3.2.11.1
probe method	3.7.3.3
process fish scaling	3.6.2.5

R

radial shake of upper end of agitator	3.5.4.1
radiant-tube firing	3.2.12.6
ready-to-use enamel	3.4.5.7
reboiling	3.6.2.14
reburning	3.2.13.2
re-circulating dip tank	3.3.2.11
reclaim	3.2.2.4
recovery time	3.2.14.15
reflection test	3.7.3.6
refractoriness	3.5.3.23
reheating time	3.2.14.10
repairing	3.2.13.3
residual stress	3.5.3.3
resistance to sudden heating	3.5.3.18
rheology	3.5.2.6
rim enameling	3.2.10.22
ripple	3.6.2.42
roller-flattening	3.2.8.6
roller-smoothing	3.2.8.6
rotary smelter	3.3.1.4
RTU enamel	3.4.5.7
rust inhibitor	3.2.1.12
rust spot	3.6.1.5

S

sagging	3.6.2.54
sand blasting	3.2.9.6
sanitary enamel	3.4.4.2
satin finish	3.5.3.26

scale specking	3.6.2.23
scaling	3.6.1.9
screen test	3.7.2.1
screening ink	3.2.1.13
screening paste	3.2.1.13
scumming	3.6.2.50
secondary treatment	3.1.2.21
self-clean	3.7.3.8
self-cleaning enamel	3.4.3.8
self-mottled ware	3.4.5.1
semi-opaque enamel	3.4.5.3
set	3.5.2.4
set up	3.5.2.4
setting-up addition	3.2.6.2
shading	3.2.11.7
sheet steel enamel	3.4.2.1
shiner-scale	3.6.2.6
shorelines	3.6.2.57
sign enamel	3.4.4.5
sliding	3.6.2.43
slip	3.1.2.9
slip gauge	3.3.2.12
slump test	3.7.2.2
slushing	3.2.10.18
slushing enameling	3.2.10.5
smelt	3.1.2.8
sodium carbonate etching test	3.7.3.16
softening temperature	3.2.14.2
soilability	3.5.3.20
solubility	3.5.3.27
spall	3.6.2.44
spalling	3.6.2.44
spark test	3.7.4.3
specking decoration	3.2.11.6
spider	3.6.2.51
sponge test	3.7.3.21
spray booth	3.3.2.5
spray gun	3.3.2.13
spraying decoration	3.2.11.2
spray-rate	3.2.14.16
squeegee oil	3.2.1.14

stainability	3.5.3.21
stainless steel enamel	3.4.2.5
star mark	3.6.2.51
stoning	3.2.13.6
strain line	3.6.2.10
substrate	3.1.1.5
sudden cooling resistance	3.5.3.17
sulfuric acid spot test	3.7.3.13
surface contaminate	3.6.2.27
surface treatment	3.1.2.17
suspension	3.5.2.3
suspension agent	3.2.6.4
swab test	3.7.3.22

T

tearing	3.6.2.17
test for air-tightness	3.7.4.4
test for fish scalindency	3.7.4.1
test for heavy metal release	3.7.3.10
tetrasodium pyrophosphate etching test	3.7.3.17
thermal shock resistance	3.5.3.12
thermal shock test	3.7.3.9
thixotropy	3.5.2.7
thread test	3.7.1.3
titanium enamel	3.2.4.1
tool mark	3.6.2.32
touch up	3.2.13.1
transfer	3.2.11.10
transfer decoration	3.2.11.3
transparent frit	3.2.2.1
triangle bars	3.3.4.9
trimming and beading	3.2.8.3
tube furnace	3.3.3.3
two coat-one fire enameling	3.4.1.6
two-cover-coat ware	3.4.1.4

U

unclear decoration pattern	3.6.3.1
U-type furnace	3.3.3.4

V

vacuum enameling	3.2.10.7
------------------------	----------

vapour degreasing	3.2.9.12
viscosity	3.5.2.8
vitreous enamel	3.1.1.1

W

warping	3.6.2.54
waste enamel	3.2.2.4
water line	3.6.2.29
water streak	3.6.2.29
waviness of metal body	3.6.1.2
wet grinding	3.2.7.2
wet process enameling	3.2.10.2
white degree	3.5.3.7
white ware	3.1.2.5
whiteness	3.5.3.7
width of pressed—face of flange	3.5.4.4

Z

zero carbon steel	3.1.5.6
zirconia enamel	3.2.4.4
